การสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืน

เสาวลักษณ์ อินแพง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนาคม 2560 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา วิทยานิพนธ์ของ เสาวลักษณ์ อินแพง ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชัยศักดิ์ อิสโร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธาน (ดร.วรวุฒิ เมืองรัตน์) _____กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชัยศักดิ์ อิสโร)

รีพระร์ ราชาวารีสูร์ กรรมการ

(คร. ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์)

M N กรรมการ

(ดร. ศรัณย์ ภิบาลชนม์)

กณะวิทยาศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เอกรัฐ ศรีสุข) วันที่ 1 เดือน มีงาววง พ.ศ. 2560

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยศักดิ์ อิสโร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้กำปรึกษาแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระกุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ คร. การะเกด เทศศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีส่วนช่วยให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้วิจัยจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยคื รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอด ระยะเวลาของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอขอบพระคุณ ณ ที่นี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณบิคา มารคา และญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้วิจัยในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเพื่อน ๆ สาขาฟิสิกส์ทุกท่านที่ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจและ สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดีตลอดมา

กุณก่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูเวทิตาแค่ บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระกุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีการศึกษาและ ประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

เสาวลักษณ์ อินแพง

56910074: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

้ กำสำคัญ: แกรฟีน/ อนุภาคนาโนแพลเลเดียม/ เซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน

เสาวลักษณ์ อินแพง: การสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาค นาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืน (FABRICATION OF HYDROGEN GAS SENSOR BASED ON PALLADIUM NANOPARTICLES DISPERSED ON GRAPHENE SHEET) คณะกรรมการ ควบคุมวิทยานิพนธ์: ชัยศักดิ์ อิสโร, Dr. rer. nat. 66 หน้า. ปี พ.ศ. 2560.

การเตรียมเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบน แผ่นแกรฟืนได้ถูกศึกษาในงานวิจัยนี้ ภายใต้การสังเคราะห์แกรฟืนบนแผ่นฟอยด์ทองแดงด้วยวิธี ตกเคลือบไอระเหยทางเคมี โดยใช้แก๊สอะเซทีลีนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน เงื่อนไขของเวลาและ อณหภมิที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนอย่ในช่วง 5-10 นาที และ 850-880 องศาเซลเซียส ตามลำคับ แกรฟีนบนแผ่นทองแคงถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ ผลที่ได้จากสเปกตรัม ของรามานพบว่า แกรฟืนที่เตรียมได้เป็นแกรฟืนหลายชั้น ยืนยันได้จากอัตราส่วนของพืก I_{zp}/I_G มี ้ ก่าน้อยกว่าหนึ่ง สำหรับในส่วนของการเตรียมอนุภาคนาโนแพลเลเดียมถูกสังเกราะห์ด้วยวิธี ้ โพลิออล ภายใต้การควบคุมขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารตั้ง ต้นแพลเลเดียมคลอไรด์ในช่วง 0.06-0.6 กรัม โดยอนภาคนาโนแพลเลเดียมถกนำไปอธิบาย ลักษณะด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscopy, TEM) ผล การศึกษาพบว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณสารตั้ง ้ต้นแพลเลเดียมกลอไรค์เพิ่มขึ้นและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภากนาโนแพลเลเดียมอยู่ในช่วง 7.7-12.0 นาโนเมตร หลังจากนั้นทำการเคลือบสารละลายแพลเลเคียมลงบนแผ่นแกรฟืนด้วยเครื่อง ้ปั่นเคลือบ และควบคมความหนาแน่นของอนภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนด้วยการ เปลี่ยนแปลงปริมาตรสารละลายแพลเลเดียมในช่วง 50-250 ไมโครลิตร อนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ ้เคลือบบนแผ่นแกรฟีนถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาลักษณะของอนุภาคบนแผ่นแกรฟีนด้วยเทคนิค อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM) ผลที่ได้พบว่า ความหนาแน่น ้ของอนุภาคนา โนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรของสารละลายแพลเลเดียมที่ ้เคลือบบนแผ่นแกรฟืนเพิ่มขึ้น สำหรับการวัดแก๊สไฮโครเจนบนพื้นฐานของการศึกษาการวัคความ ้ต้านทานไฟฟ้าของอนภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน แสดงการเปลี่ยนแปลงของความ ้ต้านทานไฟฟ้าเกิดจากการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน ซึ่งจากผลการทดลองปรากฏเปอร์เซ็นต์ การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนมีค่าเพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 3.90% ของเซนเซอร์แก๊ส ้ไฮโครเจนที่เคลือบสารละลายแพลเลเคียม 200 ไมโครลิตร บนแผ่นแกรฟีน นอกจากนี้สามารถ

ยืนยันได้ว่าการเตรียมอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีนหลายชั้นสามารถนำไปใช้ในการ ตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนและสามารถนำไปใช้เป็นเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนในเบื้องต้นได้

56910074: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: GRAPHENE/ PALLADIUM NANOPARTICLES/ HYDROGEN GAS SENSOR SAOWALUK INPAENG: FABRICATION OF HYDROGEN GAS SENSOR BASED ON PALLADIUM NANOPARTICLES DISPERSED ON GRAPHENE SHEET. ADVISORY COMMITTEE: CHAISAK ISSRO, Dr. rer. nat. 66 P. 2017.

Hydrogen gas sensor based on palladium nanoparticles dispersed on graphene sheet was studied in this research. Graphene was synthesized on copper foils by CVD method using acetylene as a carbon source. Conditions of growth time and growth temperature of graphene were in the range of 5-10 min and 850-880 ^oC, respectively. The graphene structure on copper was analyzed by Raman spectrometer. The result of Raman spectrum show that the prepared graphene has multilayers, observation from the peak ratio of $I_{2D}/I_G < 1$. For palladium nanoparticles in this experiment was synthesized by polyol method which controlled palladium nanoparticle sizes from changing amount of palladium chloride precursors in the range of 0.06-0.60 g. The palladium nanoparticles were characterized by Transmission electron microscopy (TEM). The results show that the diameter size of palladium nanoparticles increased in the range of 7.7-12.0 nm with increasing amount of palladium chloride precursors. Hydrogen gas sensor was obtained by using palladium solution coating on graphene sheets by spin-coater. The controlled density of palladium nanoparticles on graphene sheets by changing volume of palladium solution were in the range of 50-250 µl. After palladium nanoparticles coating on graphene sheet was observed by Scanning electron microscopy (SEM). The results show that the density of palladium nanoparticles on graphene sheet increased, when volume of palladium solution were coated on graphene sheet increasing. For the measurement of hydrogen gas, based on electrical resistance measurement study of the palladium nanoparticles on the graphene sheets indicates that the change in electrical resistance respond to hydrogen gas. The results present that the percentage responds on hydrogen gas gradually increases and reaches the maximum value of 3.90% for the sensor with 200 µl of palladium solution coating on graphene sheet. In addition, it confirmed that palladium nanoparticles on the multilayers graphene sheet can be applied in hydrogen gas detection and used to hydrogen gas sensor in a primary.

สารบัญ

		หน้า
บทคัด	ย่อภาษาไทย	1
บทคัด	ย่อภาษาอังกฤษ	น
สารบั	Ŋ	r
สารบั	ญตาราง	ណ
สารบั	ญภาพ	ល្ង
บทที่		
1	บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
	1.3 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	3
	1.4 ขอบเขตของการวิจัย	4
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
	2.1 แกรฟีน	5
	2.2 สมบัติของแกรฟีน	8
	2.3 วิธีการสังเคราะห์แกรฟีน	9
	2.4 ผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อการเกิดของแกรฟืนบนทองแดง	18
	2.5 ผลของความขรุขระของวัสคุรองรับทองแคงต่อการเกิดแกรฟีน โคเมนที่	
	ความดันบรรยากาศ	21
	2.6 การควบคุมการสังเคราะห์และลักษณะของอนุภาคนาโนของโลหะ	23
	2.7 เซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่มีความยืดหยุ่นโคยใช้แกรฟืนที่เคลือบด้วย	
	อนุภาคนาโนแพลเลเดียม	25
	2.8 ผลของขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมไฮบริคกับ	
	แกรฟืนต่อสมบัติการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจน	30

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า				
3	วิธีคำเนินการวิจัย	33				
	3.1 วัสคุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทคลอง	33				
	3.2 การสังเคราะห์แกรฟีน					
	3.3 การเคลื่อนย้ายแกรฟีน	36				
	3.4 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม	37				
	3.5 กระบวนการเตรียมเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	39				
	3.6 การตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน	40				
	3.7 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะตัวอย่าง	41				
4	ผลการวิจัย	42				
	4.1 ผลการศึกษาลักษณะของแกรฟีน	42				
	4.2 ผลการศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม	44				
	4.3 ผลของปริมาตรสารละลายแพลเลเดียมต่อความหนาแน่นของอนุภาค					
	นาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน	46				
	4.4 องค์ประกอบของธาตุของแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโน					
	แพลเลเคียม	48				
	4.5 ผลการตรวจวัดแก๊สไฮโครเงน	49				
5	อภิปรายและสรุปผล	60				
	ข้อเสนอแนะ	62				
บรรณานุกรม						
ประวัติ	เย่อของผู้วิจัย	66				

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินและอัตราส่วน ${ m I_{2D}}/{ m I_G}$ พีค จากรามาน	
	สเปกตัมของแกรฟีนตัวอย่างคังแสคงในภาพที่ 16	19
2	เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินและอัตราส่วน $\mathbf{I}_{_{2D}}/\mathbf{I}_{_{G}}$ พีค จากรามาน	
	สเปกตัมของแกรฟืนตัวอย่างคังแสคงในภาพที่ 17ที่	21
3	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน	36
4	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม	38
5	เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน อัตราส่วนของ I _{2D} / I _G พีค และความ	
	เข้มของ D พีก จากรามานสเปกตรัมของแกรฟีนดังภาพที่ 31	43
6	สรุปความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมต่อหน่วยพื้นที่จากการวิเคราะห์	
	ด้วยภาพถ่ายจาก SEM ดังภาพที่ 34	48

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า			
1	โครงสร้างของผลึกแบบหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งของแกรฟีน	5			
2	วัสคุนาโนคาร์บอนอัญรูปอื่นที่มีแกรฟินเป็นพื้นฐาน				
3	การจัคเรียงตัวของอิเล็กตรอนและความสัมพันธ์กับสปินใน (ก) ธาตุการ์บอน				
	(ข) s และ p ออบิทัลของการเกิดพันธะ โควาเลนต์ของอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน				
	ย่อยชั้นที่ 2 เพื่อก่อตัวเป็น 3 sp² ไฮบริดออบิทัล (ค) 3 sp² ไฮบริดออบิทัล	6			
4	ผลึกแบบหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งของแกรฟืน สี่เหลี่ยมค้านขนานที่มีค้านเท่ากัน				
	ทุกด้าน คือ Primitive unit cell กับ เบซิสของสองอะตอม คือ อะตอม A และ B	8			
5	การสังเคราะห์แกรฟินด้วยวิธีล่างขึ้นบนและวิธีบนลงล่าง	9			
6	การลอกชั้นของแกรฟินออกจากชั้นของ Highly oriented pyrolytic graphit (HOPG)				
	โดยใช้สก๊อตเทป	10			
7	(ก) ระบบการลอกชั้นของแกรฟีนออกจากแผ่นฟอยค์แกรไฟต์ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี				
	(ข) และ (ค) แผ่นฟอยค์แกรไฟต์ก่อนและหลังการลอกค้วยไฟฟ้าเกมี (ง) แผ่น				
	แกรฟีนลอยอยู่บนผิวของสารอิเล็กโตรไลต์ (จ) การกระจายตัวของแผ่นแกรฟีน				
	ในสารละลาย DMF	11			
8	กระบวนการแยกชั้นของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์โดยผ่าน				
	Li intercalation-expansion-microexplosion processes	12			
9	การสังเคราะห์แกรไฟต์ออกไซด์และแกรฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์	13			
10	ระบบการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ	14			
11	การแยกชั้นของแกรฟีนออกจากท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้วิธีเกมีเปียก	14			
12	การสังเคราะห์แกรฟืนบนซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยการอบด้วยความร้อน	15			
13	ระบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน	16			
14	กลไกการเกิดของแกรฟีนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกลและทองแดง	17			
15	กระบวนการเคลื่อนย้ายชั้นของแกรฟีนที่สังเคราะห์บนฟอยค์ทองแคงวางบน				
	วัสคุรองรับอื่น	18			
16	รามานสเปกตรัมของแกรฟีนตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 980 [°] C ภายใต้				
	เงื่อนไขที่แตกต่างกัน	19			

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
17	รามานสเปกตรัมของแกรฟืนตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน โดยมี	
	อัตราการใหลของแก๊สมีเทน 5 sccm เป็นเวลา 2 นาที	21
18	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (ก) ทองแคงที่ไม่ผ่านการขัดผิวให้เรียบ	
	ก่อนการสังเคราะห์แกรฟีน (ข) ทองแดงที่ผ่านการขัดผิวให้เรียบก่อนการ	
	สังเคราะห์แกรฟีน (ค) และ (ง) การเคลื่อนย้ายแกรฟีนวางบนวัสดุรองรับ	
	ซิลิกอนไดออกไซด์ของแกรฟินที่สังเคราะห์บนทองแดงที่ไม่ผ่านและผ่านการ	
	ขัดผิวให้เรียบตามลำดับ	22
19	ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคโลหะและอัตราส่วนของ Pt/PVP,	
	Rh/PVP และ Pd/PVP	25
20	กระบวนการสร้างเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจน โคยใช้ฟิล์มแกรฟินที่เคลือบ	
	แพลเลเคียม	26
21	(ก) สเปกตรัมรามานของแกรฟืนที่มีการเคลื่อนย้ายไปวางบนวัสคุรองรับ	
	PET และ (ข) แสดงความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้น (R₀) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	
	จากแกรฟืนที่เคลือบด้วยแพลเลเดียมที่ความหนาต่าง ๆ	27
22	เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	
	แกรฟืนและแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาต่าง ๆ	
	เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 1,000 ppm	28
23	การตรวจวัคแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนจากแกรฟีนที่เคลือบด้วย	
	อนุภาคนาโนแพลเลเคียม (ก) การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์	
	เมื่อสัมผัสกับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 1,000 ppm (ข) เปอร์เซ็นต์การ	
	เปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าเมื่อเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความ	
	เข้มข้น 20 – 1,000 ppm (ก) แสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อแก๊สและ	
	รากที่สองของความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจน (ง) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา	
	ที่ใช้ในการตอบสนองกับความเข้มข้นของใสโดรเจน	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	
24	ภาพถ่ายจาก SEM ของอนุภาคแพลเลเดียมบริสุทธิ์ที่ขนาด (ก) 25 nm, (ข) 40 nm,
	(ค) 70 nm และ อนุภาคแพลเลเคียมไฮบริคกับแกรฟีน (ง) Pd-Gr-25, (จ) Pd-Gr-40,
	(n) Pd-Gr-70
25	การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนในอนุภาคนาโนแพลเลเคียมรูปทรงสี่เหลี่ยม
	ไฮบริดกับแกรฟีน ณ อุณหภูมิห้อง ที่ความเข้มข้นไฮโครเจน (ก) 10,000 ppm
	และ (ข) ที่ความเข้มข้นไฮโครเจนต่าง ๆ
26	ระบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน
27	กระบวนการเคลื่อนย้ายแกรฟีนจากแผ่นฟอยค์ทองแคงไปวางบนขั้วอิเล็กโทรค
	บนแผ่น SiO ₂ /Si
28	กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลีออล
29	กระบวนการสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโน
	แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน
30	ระบบตรวจวัดแก๊สไฮโครเจน
31	รามานสเปกตรัมของแกรฟืนที่สังเคราะห์บนแผ่นฟอยค์ทองแคงที่อุณหภูมิ
	(f) 850 °C ແລະ (ປ) 880 °C
32	ภาพถ่ายจาก TEM ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่สังเคราะห์ด้วยวิธี โพลีออล
	ควบคุมขนาดของอนุภาคจากปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรด์ (ก) 0.06 g,
	(ป) 0.2 g, (ค) 0.4 g และ (ป) 0.6 g
33	การกระจายตัวแบบเกาส์ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคนาโน
	แพลเลเดียมที่สัมพันธ์กับภาพถ่าย TEM ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม
	ดังแสดงในภาพที่ 32 โดยใช้แพลเลเดียมคลอไรค์ (ก) 0.06 g, (ข) 0.2 g,
	(ค) 0.4 g และ (ง) 0.6 g ในการสังเคราะห์
34	ภาพถ่ายจาก SEM แสดงการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่น
	แกรฟืนที่ความหนาแน่นต่าง ๆ เมื่อทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบน
	แผ่นแกรฟืนที่ปริมาตรสารละลาย (ก) 50 µl, (ข) 100 µl, (ค) 150 µl, (ง) 200 µl
	และ (จ) 250 นโ

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้
35	สเปกตรัม EDX ของแผ่นแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมวางบนขั้ว	
	อิเล็กโทรคบนแผ่น SiO2/Si	43
36	เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	
	(ก) Pd-NP/Gr -7.7, (ป) Pd-NP/Gr -10.1, (ค) Pd-NP/Gr -11.1 และ	
	(ง) Pd-NP/Gr -12 เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ที่	
	อุณหภูมิห้อง	5
37	แถบพลังงานของแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียม (ก) ก่อน และ	
	(ข) หลังสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจน	52
38	เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	
	Pd-NP/Gr-11.1 เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ที่	
	อุณหภูมิห้อง โดยเกลือบอนุภากแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตร	
	สารละลาย 50, 100, 150, 200 และ 250 µl	54
39	การตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่ทำการ	
	เคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 150 µ1 บนแผ่นแกรฟีน (ก) เปอร์เซ็นต์	
	การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่	
	ความเข้มข้นในช่วงตั้งแต่ 1,500 – 6,000 ppm (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์	
	การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าและรากที่สองของความเข้มข้นของแก๊ส	
	ไฮโครเจน	5:
40	เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน ($ au_{ m S}$) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน	
	Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบสารละลายแพลลาเดียม 150 μl ลงบนแกรฟืน เมื่อสัมผัส	
	กับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น (ก) 1,500 ppm, (ข) 3,000 ppm, (ค) 4,500 ppm	
	ແລະ (1) 6,000 ppm	58
41	เวลาที่ใช้ในการคืนตัว (τ _R) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่	
	เคลือบสารละลายแพลเลเคียม 150 µl ลงบนแกรฟีน หลังจากสัมผัสกับแก๊ส	
	ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น (ก) 1,500 ppm, (ข) 3,000 ppm, (ค) 4,500 ppm	
	ແລະ (າ) 6,000 ppm	59

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้ ปัจจุบันพบว่า โลกได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ้ไม่เพียงแต่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแต่ยังรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมาด้วย เช่น เกิคพายุหมุนที่รุนแรง ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะ โลกร้อน คือ ้ จำนวนการปล่อยแก็สการ์บอนไคออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นออกส่บรรยากาศของโลก ไม่ว่าจะมาจาก ้อุตสาหกรรมหรือจากท่อไอเสียยานพาหนะ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการวิจัยและ พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานไฮโครเจนมาเป็นแหล่งกำเนิคพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง เนื่องจากพลังงาน ้ไฮโครเจนเป็นพลังงานสะอาค หลังจากกระบวนการเผาไหม้จะปล่อยเพียงน้ำและไอน้ำออกสู่ ้บรรยากาศ อย่างไรก็ตามพลังงานไฮโครเจนมีขีดจำกัด คือ มีกวามไวต่อการติดไฟสูงและจะถูกไหม้ ที่ความเข้มข้นต่ำสุด 4% หรือ 40,000 ppm ในอากาศ โดยความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนที่ผสมกับ อากาศจนเกิดส่วนผสมที่เหมาะสมที่จะเกิดการระเบิด (Explosive mixture) อยู่ในช่วง 4-75 % โดย ้ปริมาตรของไฮโครเจน และเนื่องจากแก๊สไฮโครเจนมีน้ำหนักเบาและมีโมเลกุลเล็กที่สุดจึงมี แนวโน้มที่จะรั่วไหลได้ง่าย (Gupta, 2009) ดังนั้นเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen gas sensor) ้จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในอนาคตหากมีการใช้พลังงานไฮโครเจนเป็น พลังงานหลัก ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนหลากหลายประเภท เช่น เซนเซอร์ แก๊สไฮโครเจนที่ใช้โลหะออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่ใช้ฟิล์มบางโลหะ และเซนเซอร์วัคด้วยคลื่นเสียง (Acoustic wave sensor) ซึ่งเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนเหล่านี้ ใช้ ประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนโดยใช้โลหะออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก ยกตัวอย่าง เช่น In₂O₃, SnO₂, ZnO และ TiO₂ เป็นต้น เนื่องจากโลหะออกไซด์เหล่านี้มีสมบัติตอบสนองต่อการ ตรวจวัดแก๊สไฮโครเจน อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่ใช้โลหะออกไซค์เป็น ้องก์ประกอบจะมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนได้คีที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 °C (Hong et al., 2015) ในปัจจุบันมีความต้องการเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่มีประสิทธิภาพในการ ์ตอบสนองต่อแก๊สสูง มีความไวต่อการตอบสนอง สามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิห้องและมี ้ประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนที่กวามเข้มข้นต่ำ ๆ ดังนั้นวัสดที่มีโกรงสร้างระดับนา ้ โนมีศักยภาพที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากวัสดุนาโนมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (Surface area to volume ratio) สูง วัสคุนาโนที่นิยมนำมาเป็นองค์ประกอบในเซนเซอร์แก๊ส

ไฮโครเจน เช่น โลหะออกไซค์ที่มีโครงสร้างระดับนาโนและวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หลักตัวอย่างเช่น ท่อนาโนคาร์บอนและแกรฟืน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโลหะ เช่น แพลทินัม (Pt) แพลเลเดียม (Pd) ทอง (Au) และเงิน (Ag) ที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของไฮโครเจนได้ดี ซึ่งมีการสังเคราะห์โลหะเหล่านี้เป็นวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนที่ อุณหภูมิห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลทินัมและแพลเลเดียมเป็นโลหะที่มีประสิทธิภาพในการเร่ง ปฏิกิริยาการแตกตัวโมเลกุลไฮโครเจนเป็นอะตอมไฮโครเจนที่อุณหภูมิห้อง (Phan & Chung, 2014 a)

้สำหรับกลุ่มโลหะที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา วัสคุนาโนแพลเลเดียมนิยมนำใช้เป็น ้องค์ประกอบในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน เนื่องจากฟิล์มบางแพลเลเดียมหรือโลหะผสมแพลเลเดียม ้มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้นสูงเพราะมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อ ้ปริมาตรน้อย เพื่อให้สามารถตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนที่กวามเข้มข้นต่ำ ๆ ได้ วัสคนาโนแพลเลเดียม ในรูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ เช่น อนุภาคนาโนแพลเลเดียม (Palladium nanoparticle) แท่งนาโน แพลเลเดียม (Palladium nanorod) และลวดนาโนแพลเลเดียม (Palladium nanowire) จึงเป็นวัสดที่มี ้ความต้องการ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโครเจนที่ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับ ้วัสคุนาโนแพลเลเดียมโครงสร้างอื่น ๆ ในเรื่องของการสังเคราะห์และความสามารถในการดูคซับ ้และคายไฮโครเจน ตรงข้ามกับวัสคนาโนแพลเลเคียมโครงสร้างอื่นซึ่งมีรอยต่อเป็นจำนวนมาก ระหว่างอนุภาคและกระบวนการในการสังเคราะห์ค่อนข้างซับซ้อน (Noh, Lee, & Lee, 2011) เป็น ้เรื่องยากที่จะสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมมาเป็นองค์ประกอบในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน เพราะความไม่ต่อเนื่องของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม เนื่องจากขาดการเชื่อมต่อระหว่างอนุภากจึง ้ส่งผลทำให้การนำไฟฟ้าต่ำ เพื่อพัฒนาการนำไฟฟ้าในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่มีอนุภาคนาโน ้แพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมจำเป็นต้องขึ้นรูปเป็นองค์ประกอบหรือ ้ไฮบริคกับวัสดุที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ เช่น พอลิเมอร์ โลหะออกไซค์ และวัสดุที่มีการ์บอนเป็น องค์ประกอบ (Phan & Chung, 2014 b)

แกรฟินเป็นวัสดุขนาดสองมิติที่มีอะตอมการ์บอนเป็นองก์ประกอบ มีความหนาของ อะตอมการ์บอนเพียงชั้นเดียวและมี โครงสร้างผลึกแบบหกเหลี่ยม (Hexagonal) แสดงสมบัติการนำ ไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม ที่อุณหภูมิห้องแกรฟินมีความเสถียรมากเมื่อเทียบกับวัสดุที่มี การ์บอนเป็นองก์ประกอบในอัญรูปแบบอื่น แกรฟินมีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าได้สูง มี กวามเลื่อยทางเกมี นำความร้อนสูง แสงสามารถส่องผ่านได้และมีความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด แกรฟินเป็นวัสดุกึ่งโลหะหรือเป็นวัสดุกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างระหว่างชั้นพลังงานเท่ากับศูนย์ (zero – band gap) (Galib, 2012) และยังเป็นวัสดุที่มีศักยภาพในการตรวจวัดแก๊สในระดับโมเลกุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่ใช้แกรฟินเป็นองค์ประกอบหลักให้มี ประสิทธิภาพในการตรวจวัดแก๊สที่ระดับโมเลกุลเพิ่มขึ้น จำเป็นด้องเพิ่มหมู่ฟังก์ชันในแกรฟิน งานวิจัยนี้ ทำการวัดการเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน ด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟิน (Pd-NP/Gr) ที่ความเข้มข้นของ แก๊สไฮโดรเจนต่าง ๆ ณ อุณหภูมิห้อง ทำการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียมลงบนแกรฟินด้วยวิธี ปั่นเกลือบ (Spin-coating) จากการที่แกรฟินมีสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมช่วยให้การเคลื่อนที่และ การถ่ายโอนอิเล็กตรอนดียิ่งขึ้นและแกรฟินยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาให้กับตัวเร่งปฏิกิริยา อนุภาคนาโนแพลเลเดียมให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแกรฟินมีพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาให้กับตัวเร่งปฏิกิริยา สังเคราะห์แกรฟินจะเลือกใช้วิธีตกเคลือบไอระเหยทางเกมี (Chamical Vapor Deposition, CVD) ลงบนแผ่นฟอยด์ทองแดง เนื่องจากวิธี CVD สามารถเกลื่อนย้ายแกรฟินไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 สึกษาการสังเคราะห์แกรฟืนด้วยวิธี CVD โดยใช้แก๊สอะเซทิลีนเป็นแหล่งกำเนิด การ์บอน

 สึกษาการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาแน่นต่าง ๆ กันบนแผ่น แกรฟืน

 สึกษาการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัว ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนที่ความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโดรเจนต่าง ๆ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 สามารถเตรียมเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนด้วยวิธีปั่นเคลือบ

 เข้าใจพฤติกรรมการตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจนของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจนค้วย การกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน

 สามารถอธิบายกล ใกและผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืนด้วย
 วิธี CVD บนแผ่นฟอยด์ทองแดง โดยมีแก๊สอะเซทิลีนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอนต่อการเกิดของ แกรฟืนได้

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์แกรฟืนบนแผ่นฟอยค์ทองแคงด้วยวิธี CVD โดย ใช้แก๊สอะเซทิลีนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน เพื่อนำแกรฟืนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดมาสร้างเซนเซอร์ แก๊ส ไฮโดรเจนด้วยการกระจายของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืน โดยทำการเคลือบ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาแน่นต่าง ๆ ลงบนแผ่นแกรฟืนด้วยวิธีปั่นเคลือบ ศึกษาการ ตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน ไฟฟ้าด้วยวิธี 2 โพรบ ภายใต้เงื่อนไขความเข้มข้นของไฮโดรเจนที่แตกต่างกัน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แกรฟีน (Graphene)

คาร์บอนเป็นธาตุหมู่ที่ 4 ที่มีความไวต่อการสร้างโมเลกุลของสารประกอบและผลึก ของแข็ง คาร์บอนมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 อิเล็กตรอน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยากับอะตอม การ์บอนอื่น ๆ เพื่อสร้างการ์บอนในอัญรูปต่าง ๆ แกรฟินเป็นอัญรูปหนึ่งของวัสคุที่มีอะตอมของ การ์บอนเป็นองก์ประกอบ อะตอมของการ์บอนจับตัวกันด้วยพันธะโควาเลนส์ในแนวระนาบเป็น ผลึกแบบหกเหลี่ยมกล้ายรังผึ้ง แกรฟินเป็นวัสคุขนาดสองมิติที่มีความหนาของอะตอมการ์บอน เพียงชั้นเดียวดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 โครงสร้างของผลึกแบบหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งของแกรฟีน (Galib, 2012)

แกรฟินเป็นโครงสร้างพื้นฐานของวัสอุที่มีอะตอมของการ์บอนเป็นองค์ประกอบอัญรูป อื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 เมื่อแกรฟินเกิดการม้วนตัวเป็นทรงกลมทำให้เกิดเป็นบักกี้บอล แกรฟิน ม้วนเป็นทรงกระบอกทำให้เกิดเป็นท่อนาโนการ์บอนและเมื่อแผ่นแกรฟินซ้อนทับกันหลาย ๆ ชั้น เกิดเป็นแกรไฟต์



ภาพที่ 2 วัสคุนาโนการ์บอนอัญรูปอื่นที่มีแกรฟีนเป็นพื้นฐาน (Mwakikunga & Hillie, 2011)

ในแกรฟินอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้น 2s ออบิทัล จับตัวกับอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้น 2p_x และ 2p_y ออบิทัล ทำให้เกิดเป็น 3 sp² ไฮบริดออบิทัลขึ้น ซึ่งการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนดังภาพที่ 3 ผล จากการจับตัวกันของอิเล็กตรอนแบบ sp² ในพันธะสามเรียกว่าพันธะซิกม่า (σ-bonds) ซึ่งเป็น พันธะที่แข็งแรงที่สุดของพันธะโควาเลนส์ อิเล็กตรอนในชั้น 2p_z ที่จับตัวกันด้วยพันธะโควาเลนส์ หรือเรียกว่าพันธะพาย (π-bonds) (Wong & Akinwande, 2011)



ภาพที่ 3 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนและความสัมพันธ์กับสปินใน (ก) ธาตุการ์บอน (ข) s และ p ออบิทัลของการเกิดพันธะ โควาเลนต์ของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยชั้นที่ 2 เพื่อก่อ ตัวเป็น 3 sp² ไฮบริดออบิทัล (ก) 3 sp² ไฮบริดออบิทัล (Wong & Akinwande, 2011) Wong and Akinwande (2011) อธิบายระบบโครงผลึกคล้ายรังผึ้งในแกรฟินโดยใช้ โมเดลของบอลและสติก (ball and stick model) โดยที่ลูกบอล คือ อะตอมของการ์บอน สัญลักษณ์ ที่เป็นเส้นดำทึบ แสดงถึงอะตอมของการ์บอนที่จับตัวกันด้วยพันธะซิกมา ความยาวของพันธะ ระหว่างอะตอมของการ์บอน (a_{c-c}) มีค่าประมาณ 1.42 Å ผลึกแบบรังผึ้งประกอบด้วยระบบโครง ผลึก (Bravais lattice) กับ หนึ่งเบซิส (Basis) ของสองอะตอมดังแสดงในภาพที่ 4 คืออะตอม A และ B ถ้ารวมระบบโครงผลึกทั้งหมดเข้าด้วยกันจะมี 2 พายอิเล็กตรอนต่อหนึ่งหน่วยเซลล์ โดยพื้นฐาน ระบบโครงผลึกแบบหกเหลี่ยมและมีหน่วยเซลล์ (Primitive unit cell) ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน โดยที่ a = √3a_{c-c} = 2.46 Å พริมิทีฟเวกเตอร์ตามที่ กำหนดดังภาพที่ 4 มีค่าเท่ากับ

$$a_1 = \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}\right), a_2 = \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{-2}\right) \tag{1}$$

เมื่อ |a₁| = |a₂| = a แต่ละอะตอมของการ์บอนจับตัวกับอะตอมที่อยู่ใกล้ที่สุด 3 อะตอม เวกเตอร์ ระหว่างอะตอม A และอะตอมที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออะตอม B ดังแสดงในภาพที่ 4 เป็นไปตามสมการ ที่ (2)

$$R_{1} = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, 0\right), R_{2} = -a_{2} + R_{1} = \left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}, -\frac{a}{2}\right),$$

$$R_{3} = -a_{1} + R_{1} = \left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}, \frac{a}{2}\right)$$
(2)

ເມື່ອ $|\mathbf{R}_1| = |\mathbf{R}_2| = |\mathbf{R}_3| = \mathbf{a}_{C-C}$



ภาพที่ 4 ผลึกแบบหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งของแกรฟีน สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน คือ Primitive unit cell กับ เบซิสของสองอะตอม คือ อะตอม A และ B (Wong & Akinwande, 2011)

2.2 สมบัติของแกรฟีน

แกรฟินเป็นวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม เนื่องจากแกรฟินเป็นวัสดุที่มีอะดอมของ การ์บอนหนาเพียงชั้นเดียวและเป็นวัสดุที่บาง แก็ส ไม่สามารถแพร่ผ่านได้ มีความแข็งแรงกว่าเหล็ก (ก่ามอดูลัสของยังประมาณ 1 TPa) นอกจากนี้ค่าการนำความร้อนของแกรฟินที่อุณหภูมิห้องมีค่า มากกว่า 5000 W m⁻¹K⁻¹ เทียบเท่ากับค่าการนำความร้อนของท่อนาโนคาร์บอนที่รวมตัวกันเป็นมัด และยิ่งกว่านั้น แกรฟินยังมีค่าการนำความร้อนใกล้เคียงกับค่าการนำความร้อนของแพชร ซึ่งเพชร เป็นอัญรูปหนึ่งของคาร์บอนที่มีสมบัติการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม แกรฟินเป็นวัสดุที่มีความหนาของ คาร์บอนเพียงชั้นเดียวที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ (2,630 m² g⁻¹) มีสมบัติเกือบ โปร่งแสง มีค่าการ ดูดกลืนแสง ~ 2.3 % ของแสงสีขาว แกรฟินยังสามารถคืนสภาพเดิมได้และมีสมบัติทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน อย่างเช่น มีค่า charge carrier mobility สูง (มากกว่า 200,000 cm² V⁻¹ s⁻¹) ส่งผลทำให้แกรฟินมีค่าการนำไฟฟ้าดีเยี่ยม การนำไฟฟ้าของแกรฟินเกิดจาก การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในแกรฟิน ซึ่งมีพฤติกรรมเลียนแบบอนุภาคเฟอร์มิออน (Massless fermions) ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายโดยใช้สมการดิเรก (Dirac-like equation) มากกว่าที่จะใช้ สมการชเรอดิงเงอร์ (Schrödinger equation) เป็นผลมาจากการที่อิเล็กตรอนในแกรฟินเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วเฟอร์มิ (Fermi velocity, V_F ~ 1×10[°] m s⁻¹) ในระยะทางระดับไมโกรเมตรโดยไม่มีการ กระเจิงของอิเล็กตรอนเกิดขึ้น (Edward & Coleman, 2013)

2.3 วิธีการสังเคราะห์แกรฟีน

Edward and Coleman (2013) ได้รวบรวมวิธีการสังเคราะห์แกรฟืน ซึ่งสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 วิธี ที่แตกต่างกัน คือ วิธีบนลงล่าง (Top-down method) และวิธีล่างขึ้นบน (Bottom-up method) ดังแสดงในภาพที่ 5



ภาพที่ 5 การสังเคราะห์แกรฟืนด้วยวิธีล่างขึ้นบนและวิธีบนลงล่าง (Edward & Coleman, 2013)

2.3.1 วิธีบนลงล่าง (top-down method)

วิธีบนลงล่าง คือ วิธีที่ใช้ในการแยกชั้นของแกรฟีนออกจากชั้นของแกรไฟต์ที่ซ้อนทับ กันออกเป็นชั้น ๆ โดยที่แต่ละชั้นของแกรไฟต์ที่ซ้อนทับกันยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (Van der waals forces) โดยสามารถแบ่งออกเป็นวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.3.1.1 Micromechanical Cleavage

วิธีสก๊อตเทป เป็นวิธีการลอกชั้นแกร ไฟต์โดยใช้เทปติดเพื่อลอกชั้นของแกร ไฟต์ ออกเป็นชั้น ๆ และเป็นวิธีแรกที่ใช้ในการทดลองในการแยกชั้นของแกรฟีน การลอกซ้ำ ๆ ทำให้ เกิดแกรฟีนชั้นเดียว แกรฟีนสองชั้นและแกรฟีนสองหรือสามชั้นดังแสดงในภาพที่ 6 วิธีการนี้ แกรฟีนจะมีคุณภาพสูง แต่วิธีการนี้ไม่สามารถควบคุมขนาดและจำนวนชั้นของแกรฟีนได้ รวมทั้ง กระบวนการสังเคราะห์แกรฟีนค่อนข้างช้าและต้องมีความละเอียดสูง



ภาพที่ 6 การลอกชั้นของแกรฟืนออกจากชั้นของ Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) โดย ใช้สก๊อตเทป (Singh et al., 2011)

2.3.1.2 การลอกโดยใช้ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Exfoliation)

วิธีการลอกชั้นแกรฟินออกจากชั้นของแกรไฟต์ดังแสดงในภาพที่ 7 (ก) ใช้แกรไฟต์ เป็น sacrificial electrode และทำการลอกชั้นของแกรไฟต์โดยใช้สารละลายอิเล็กโตรไลด์ (Electrolyte solution) ผสมกับสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) สารละลายอิเล็กโตรไลต์ คือ สารละลายของกรดซัลฟีวริกและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (H₂SO₄-KOH) โดยสารลดแรงดึงผิว ช่วยป้องกันการรวมตัวเข้าเป็นก้อนของแผ่นแกรฟินและยังช่วยป้องกันแกรฟินจากการทำปฏิกิริยา ระหว่างกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic groups) กับ **π**-orbital ของแกรฟิน สารละลายกรด ซัลฟีวริกเป็นสารละลายอิเล็กโตรไลด์ที่ดีสำหรับการลอกชั้นของแกรไฟต์ออกจากกัน แต่ สารละลายกรดซัลฟีวริกยังส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาออกชิเดชันระหว่างชั้นของแกรไฟต์ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องผสมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลด์เพื่อ ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างชั้นของแกรฟิน สารละลาย H₂SO₄ และ KOH ที่ใช้เป็นสาร อิเล็กโตรไลต์ในการลอกชั้นของแกรไฟต์ด้วยวิธีการลอกโดยใช้ไฟฟ้าเคมีจะให้ผลิตภัณฑ์ชั้นของ แกรไฟต์ที่มีความหนาแตกต่างกันผสมกันอยู่ ทำการแยกชั้นของแกรฟิน 2-3 ชั้นโดยการปั่นแยก วิธีการนี้กำจัดสารลดแรงดึงผิวออกจากแกรฟินได้ยาก ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติ ทางไฟฟ้าเคมีของแกรฟิน การแยกชั้นของแกรฟินกระทำได้ยาก เนื่องจากวิธีการนี้จะได้ผลิตภัณฑ์



ภาพที่ 7 (ก) ระบบการลอกชั้นของแกรฟีนออกจากแผ่นฟอยค์แกรไฟต์ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี (ข) และ (ค) แผ่นฟอยค์แกรไฟต์ก่อนและหลังการลอกด้วยไฟฟ้าเคมี (ง) แผ่นแกรฟีนลอย อยู่บนผิวของสารอิเล็กโตรไลต์ (ง) การกระจายตัวของแผ่นแกรฟีนในสารละลาย DMF (Tripathi, Patel, Shaz, & Srivastava, n.d.)

2.3.1.3 Exfoliation of graphene intercalation compounds (GICs)

วิธีการนี้ เป็นการลอกชั้นของแกรฟืนออกจาก GICs โดยใช้ตัวทำละลายและความ ร้อนช่วยในการลอกชั้นของแกรฟืน สำหรับการใช้ตัวทำละลายช่วยในการแยกชั้นของแกรฟืนออก จาก GICs โดยทั่วไปเป็นวิธีการที่นำ GICs ไปโซนิกคตในสารละลายเพื่อแยกชั้นของแกรฟืน ออกมา เช่น การนำเอาโลหะแอลคาไลน์ GICs ไปโซนิเคตใน NMP (N-methylpyrrolidone) และ เอทานอล (ethanol) เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นการนำ Li- GICs ไปโซนิเคตในน้ำดังแสดงในภาพที่ 8 สำหรับวิธีให้ความร้อนกับ GICs เพื่อแยกชั้นของแกรฟืนนั้น โดยทั่วไปจะเกิดการตกเกลือบทาง ความร้อนของอินเทอร์กาเลชันของแก๊สบางชนิดภายในชั้น GICs แก๊สเหล่านั้นจะเป็นตัวผลักชั้น ของแกรฟืนออกมาเป็นชั้น ๆ



ภาพที่ 8 กระบวนการแยกชั้นของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์โดยผ่าน Li intercalation– expansion–microexplosion processes (Edward & Coleman, 2013)

2.3.1.4 การลอกชั้นของแกรไฟต์ออกไซด์ (Exfoliation of graphite oxide) เป็นวิธีการสังเคราะห์แกรฟินโดยการใช้กรดแก่หรือด้วออกซิแดนท์มาออกซิไดซ์ แกรไฟต์ให้ได้เป็นแกรไฟต์ออกไซด์ ซึ่งหมู่ของออกไซด์ ไฮดรอกซิล การ์บอกซิลิกและการ์บอนิล จะเข้าไปแทรกและเกาะเต็มระนาบพื้นผิวในแต่ละชั้นของแกรไฟต์ ทำให้แต่ละชั้นของแกรไฟต์ กว้างขึ้นและลดแรงแวนเดอร์วาล์วระหว่างชั้น หากแกรไฟต์ออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแรงเพียงนิด เดียว เช่น การใช้กลื่นความถิ่สูง (Sonication) ก็สามารถหลุดออกเป็นแกรฟินออกไซด์ (Graphene oxide) ได้ ดังแสดงในภาพที่ 9 ซึ่งแกรฟินออกไซด์มีสมบัติเป็นไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) ละลายได้ ดีในน้ำแต่ไม่นำไฟฟ้าและสามารถรีดิวซ์ด้วยสารรีดักแทนซ์ เช่น ไฮดราซีนไฮเดรตได้เป็นรีดิวซ์ แกรฟินออกไซด์ (Reduced graphene oxide) ซึ่งสามารถกรองและกระจายตัวได้ดีบนวัสดุรองรับ เกิดเป็นฟิล์มบางนำไฟฟ้า โดยทั่วไปการสังเคราะห์แกรฟินออกไซด์มีอยู่ 3 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ วิธี Hummers method วิธีนี้ใช้ H₂SO4 และ KMnO4 เป็นตัวออกซิไดซ์ graphite flakes ที่มีความบริสุทธิ์ สูง มี Localizes defects ใน p-structure จึงเป็นเหตุในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน นำสารละลาย ดังกล่าวมาโซนิเคตจะได้สารละลายแกรฟินออกไซด์ ใช้ไฮดราซีนไฮเดรต (Hydrazine hydrate) เพื่อวิติวซ์กลับเป็นแกรฟินอีกครั้ง



ภาพที่ 9 การสังเคราะห์แกรไฟต์ออกไซด์และแกรฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์ (Garg, Bisht, & Ling, 2014)

2.3.1.5 อาร์คดิสชาร์จ (Arc discharge)

เป็นวิธีการจ่ายกระแส ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระหว่างขั้วไฟฟ้าที่เป็นแท่งแกร ไฟต์ 2 แท่ง มีความต่างศักย์ประมาณ 20 – 40 โวลต์ ตกคร่อมระหว่างแท่งแกร ไฟต์สองแท่งภายใต้ บรรยากาศของแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียมหรืออาร์กอน จะทำให้เกิดสถานะพลาสมาและอุณหภูมิสูง บริเวณระหว่างขั้วอิเล็ก โทรคส่งผลให้แท่งแกร ไฟต์เกิดการระเหยกลายเป็น ไอแล้วควบแน่นเป็นท่อ นาโนคาร์บอนคังแสดงในภาพที่ 10 วิธีการนี้นิยมใช้ในการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนรวมทั้ง ท่อนาโนคาร์บอนและฟูเลอรีน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการนำวิธีอาร์คดิสชาร์จมาใช้ในการสังเคราะห์ แกรฟืน 2-3 ชั้น ในบรรยากาศของบัฟเฟอร์แก๊ส การใช้แก๊ส ไฮโครเจนเป็นส่วนผสมในบัฟเฟอร์ แก๊สมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากแก๊ส ไฮโครเจนจะ ไปช่วยยุติการแกว่งของพันธะระหว่าง การ์บอนทำให้ช่วยยับยั้งการม้วนตัวของการ์บอนในชั้นแกรฟืน ส่งผลทำให้อะตอมของการ์บอนจับ กันเป็นแผ่นคล้ายแผ่นแกร ไฟต์



ภาพที่ 10 ระบบการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ (Ando & Zhao, 2006)

2.3.1.6 Unzipping carbon nanotube

แกรฟินหรือแกรฟิน 2-3 ชั้น สามารถสังเคราะห์ใด้จากท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียว หรือหลายชั้น ด้วยการแยกผนังของท่อนาโนคาร์บอนออกจากกันโดยใช้วิธีทางกายภาพและทาง เคมีดังแสดงในภาพที่ 11 เช่น วิธีเคมีเปียก (Wet chemistry methods) เช่น วิธีการออกซิใดซ์หรือวิธี ทางกายภาพ เช่น ยิ่งเลเซอร์ (Laser irradiation) และ การกัดด้วยพลาสมา (Plasma etching) การ สังเคราะห์แกรฟินจากการแยกผนังของท่อนาโนคาร์บอน ส่งผลทำให้ได้แผ่นแกรฟินนาโนริบบอน (graphene nanoribbons) ความกว้างของแผ่นแกรฟินวัดได้จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ



ภาพที่ 11 การแยกชั้นของแกรฟีนออกจากท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้วิธีเคมีเปียก (Xiao et al., 2014)

2.3.2 วิธีล่างขึ้นบน (bottom-up method)

วิธีล่างขึ้นบน คือ การสังเคราะห์แกรฟีนจากการเลือกบรรจุอะตอมของคาร์บอนจาก แหล่งกำเนิดการ์บอนลงบนวัสคุรองรับที่แน่นอน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.3.2.1 Epitaxial growth on silicon carbide

เป็นวิธีที่ทำการปลูกแกรฟืนบนซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 °C ภายใต้เงื่อนไขสุญญากาศสูงมาก (UHV 10⁻⁷ Pa) โดยการให้ความร้อนแก่ซิลิกอนคาร์ไบด์ ทำให้ อะตอมของซิลิกอนบางส่วนเกิดการระเหิดออกมาจากผิวของซิลิกอนคาร์ไบด์ หลังจากนั้นจะเกิด การกัดกร่อนแบบแกรไฟต์ (graphitisation) ของอะตอมคาร์บอนทิ้งไว้ข้างหลัง ทำให้เกิดชั้นของ แกรฟืนขึ้นดังแสดงในภาพที่ 12 วิธีการนี้ทำการเคลื่อนย้ายแกรฟืนไปไว้บนวัสดุรองรับอื่น ๆ ได้ ยาก เมื่อต้องการนำแกรฟืนไปประยุกต์ใช้



ภาพที่12 การสังเคราะห์แกรฟินบนซิลิกอนคาร์ไบค์ด้วยการอบด้วยความร้อน (Hibino, Kageshima, & Nagase, 2010)

2.3.2.2 วิธีตกเคลือบใอระเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD)

วิธีการสังเคราะห์แกรฟินด้วยวิธี CVD เป็นการสังเคราะห์แกรฟินที่อุณหภูมิในช่วง 750-1000 ⁶C บนโลหะทรานซิชัน เช่น Fe, Ru, Co, Rh, Ir, Ni, Pd และ Cu เป็นต้น วิธีการสังเคราะห์ แกรฟินบนโลหะทรานซิชันด้วยวิธี CVD เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยที่กระบวนการนี้เกิด จากการให้ความร้อนแก่โมเลกุลของแก็สหรือของเหลวที่เป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนทำให้โมเลกุล เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นแก๊สซึ่งเรียกว่าสารตั้งต้น โมเลกุลของแก๊สหรือไอระเหยของของเหลว จะเกิดปฏิกิริยาเมื่อเข้าใกล้กับวัสดุรองรับที่มีความร้อนและเกิดการแตกตัวและรวมตัวใหม่เป็นวัสดุ ที่เป็นของแข็งในรูปแบบของฟิล์มบาง จากภาพที่ 13 แสดงระบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์

แกรฟืนซึ่งประกอบด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือวัสดุรองรับ แหล่งกำเนิดแก๊สไฮโดรการ์บอน แก๊ส พาหะ (แก๊สจำพวกแก๊สเฉื่อย) และเตาปฏิกรณ์สำหรับให้ความร้อน



ภาพที่ 13 ระบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน (Galib, 2012)

กลไกการเกิดของแกรฟืนบนทองแดงและโลหะทรานซิชันอื่น ๆ ด้วยวิธี CVD โลหะทรานซิซันมีบทบาทเป็นได้ทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุรองรับในกระบวนการ สังเคราะห์แกรฟืนด้วยวิธี CVD จากภาพที่ 14 แสดงกลไกความแตกต่างการเกิดของแกรฟืนบน Cu และ Ni โดยทั่วไปการเร่งปฏิกิริยาทางเกมีในกระบวนการ CVD ด้วยความร้อน ส่งผลทำให้เกิดการ แตกตัวของแก๊สไฮโดรการ์บอนและเกิดการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ถ้า กระบวนการต่าง ๆ ทั้งการดูดซับ การแตกตัวและการแพร่ของโมเลกุลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา จะเกิดแกรฟืนชั้นเดียวขึ้น ซึ่งกลไกนี้เกิดขึ้นเฉพาะบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นทองแดง เนื่องจาก การ์บอนมีการละถายบนพื้นผิวของทองแดงด่ำ แต่การสังเกราะห์แกรฟืนบนนิกเกิลและโลหะ ทรานซิชันอื่น ๆ (Co, Ru, Ir และ อื่น ๆ) จะเกิดการแตกตัวของโมเลกุลไฮโดรการ์บอนเนื่องจาก ความร้อนในระบบ CVD และเกิดการดูดซับอะตอมของการ์บอนบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ โดย แกรฟืนเกิดการก่อตัวขึ้นในระหว่างกระบวนการทำให้ระบบเย็นตัว เนื่องจากเกิดการละลายของ การ์บอนสูง ส่งผลทำให้อะตอมของการ์บอนแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุรองรับและต่อมาเกิดการ ตกตะกอนสะสมที่พื้นผิวของวัสดุรองรับเกิดเป็นแกรฟืนขึ้น



ภาพที่ 14 กลไกการเกิดของแกรฟินบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลและทองแดง (Muñoz & Aleixandre, 2013)

การเคลื่อนย้ายแกรฟีน

แกรฟินที่ทำการสังเคราะห์บนโลหะทรานซิชัน ควรที่จะทำการเคลื่อนย้ายชั้นของ แกรฟินไปวางไว้บนวัสดุรองรับที่เป็นฉนวน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเคลื่อนย้ายแกรฟินโดยทั่วไปสำหรับแกรฟินที่ สังเคราะห์ด้วยวิธี CVD บนโลหะทรานซิชันดังแสดงในภาพที่ 15 Kumar and Lee (2013) ทำการ เกลือบพอลิเมอร์จำพวกพอลิเมทิลเมทาคริเลต (Poly Methyl Methacrylate, PMMA) หรือ พอลิ เมทิลซิโลเซน (Poly dimethylsiloxane, PDMS) ลงบนแกรฟินด้วยวิธีปั่นเคลือบ โดยที่พอลิเมอร์ที่ เกลือบลงไปบนแกรฟินจะช่วยรักษาโครงสร้างของแกรฟินในระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย ขั้นตอนต่อมาทำการกำจัดวัสดุรองรับออก เช่น ถ้าใช้วัสดุรองรับเป็นทองแดง ทำการกำจัดทองแดง ออกโดยใช้สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl₃) ผสมกับสารละลายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การกำจัดทองแดงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ผสมกับสารละลาย HCl, HNO₃, Fe(NO₃)₃, (NH₄)₂SO₈ และ CuCl₂ หลังจากที่ทองแดงถูกกำจัดเสร็จสมบูรณ์จะเหลือชั้นของ PMMA/graphene ลอยอยู่ ทำ การเคลื่อนข้ายชั้นของ PMMA/graphene โดยจุ่มลงในน้ำกลั่น 7-8 ครั้ง เพื่อล้างสิ่งตกค้างที่เกิดจาก กระบวนการกำจัดทองแดง นำชั้นของ PMMA/graphene วางไว้บนวัสดุรองรับตามที่ด้องการ ต่อมา ทำการกำจัด PMMA โดยการนำชั้นของ PMMA/graphene/substrate ไปแช่ในอะซิโตนหรือ คลอโรฟอร์มเพื่อให้ PMMA ละลายออกไปจะได้ฟิล์มแกรฟินที่สมบูรณ์เกิดขึ้น



ภาพที่ 15 กระบวนการเคลื่อนย้ายชั้นของแกรฟินที่สังเคราะห์บนฟอยค์ทองแคงวางบน วัสดุรองรับอื่น (Kumar & Lee, 2013)

2.4 ผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อการเกิดของแกรฟีนบนทองแดง

Mohsin (2012) ทำการสังเคราะห์แกรฟินด้วยวิธี CVD ที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure chemical vapor deposition, APCVD) และศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อการเกิดของแกรฟิน โดยการวิเคราะห์จากรามานสเปกตรัม พารามิเตอร์ที่สำคัญในกระบวนการ สังเคราะห์แกรฟินด้วยวิธี APCVD ได้แก่ อัตราไหลของแก๊สตั้งต้น (Precursor gas) อุณหภูมิและ เวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟิน ในการทดลองนี้ใช้แก๊สมีเทน (CH₄) เป็นแก๊สตั้งต้น แก๊ส อาร์กอน (Ar) และแก๊สไฮโดรเจน (H₂) เป็นแก๊สพาหะ โดยมีแผ่นฟอยด์ทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการสังเคราะห์แกรฟิน ซึ่งสามารถสรุปผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อการเกิดของแกรฟินได้ดังนี้ ผลของอัตราการไหลของสารตั้งด้นและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินต่อการเกิด ของแกรฟิน

เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลของแก๊สตั้งด้นและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินต่อ การเกิดของแกรฟิน โดยทางผู้วิจัยทำการสังเคราะห์แกรฟินที่อุณหภูมิ 980 °C เงื่อนไขที่ใช้ในการ สังเคราะห์แกรฟินและอัตราส่วน I_{2D}/I_G พีค จากการวิเคราะห์แกรฟินตัวอย่างด้วยเทคนิครามาน สเปกโตรสโกปีดังแสดงในภาพที่ 16 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1

หมายเลข	อุณหภูมิ	อัตราใหลของแก๊สมีเทน	ເວລາ	I_{2D}/I_{G}
ตัวอย่าง	(°C)	(sccm)	(นาที)	
1	980	10	5	1.08
2	980	10	10	0.94
3	980	10	20	0.87
4	980	20	5	1.04
5	980	20	10	0.453
6	980	20	20	0.34

ตารางที่ 1 เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนและอัตราส่วน I_{2D}/I_G พีค จากรามานสเปกตัมของ แกรฟีนตัวอย่างคังแสดงในภาพที่ 16 (Mohsin, 2012)



ภาพที่ 16 รามานสเปกตรัมของแกรฟีนตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 980 ⁰C ภายใต้เงื่อนไขที่แตก ต่างกัน (Mohsin, 2012)

้จากภาพที่ 16 แสดงรามานสเปกตัมของแกรฟีนตัวอย่างโดยใช้เงื่อนไขในการสังเคราะห์ แกรฟีนสรุปคังตารางที่ 1 พืกที่สำคัญจากรามานสเปกตรัมในแกรฟีนชั้นเดียวประกอบค้วย D, G และ 2D พีค ซึ่งมีตำแหน่งพีคของรามาน (Raman Shift , cm⁻¹) ที่ตำแหน่ง 1350 cm⁻¹, 1580 cm⁻¹ และ 2700 ${
m cm}^{-1}$ ตามลำคับ อัตราส่วน ${
m I}_{2D}/{
m I}_G$ พีค เป็นปริมาณที่เป็นตัวกำหนดจำนวนชั้นของแกรฟืน ้จากภาพที่ 16 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน I_{2D}/I_G พีค ลดลงเมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน ้เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั้นของแกรฟีนเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนมาก ขึ้น จากตารางที่ 1 อัตราส่วน ${
m I_{2D}/I_G}\sim 1$ เมื่อใช้เวลาในการสังเคราะห์แกรฟัน 5 นาที ที่อัตราการไหล ของแก๊สมีเทน 10 sccm และ 20 sccm แสคงให้เห็นว่าเป็นแกรฟินสองชั้น และภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืน ค่าอัตราส่วน $\mathbf{I}_{2\mathrm{D}}/\mathbf{I}_{\mathrm{G}} < 1$ แสดงว่าเกิดแกรฟืนสองหรือสามชั้นและที่ ้อัตราการใหลของแก๊สมีเทน 20 sccm ค่าอัตราส่วน I_{2D}/I_G ลดต่ำลง เมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ แกรฟืนเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับอัตราการไหลของแก๊สมีเทนที่ 10 sccm ที่เงื่อนไขเดียวกันของการ ้สังเคราะห์แกรฟีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการใหลของแก๊สมีเทนที่ต่ำกว่าเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ ในการควบคุมจำนวนชั้นของแกรฟีนภายใต้การสังเคราะห์แกรฟีนด้วยวิธี APCVD จากรุปที่ 16 ์ แสดงให้เห็นว่าความเข้มของ D พีค เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนและจำนวนชั้น ้งองแกรฟีนเพิ่มขึ้น จากการทคลองในงานวิจัยนี้ สามารถสรปได้ว่า เมื่ออัตราการไหลของแก๊สตั้ง ้ต้นมีปริมาณต่ำและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินน้อยจะเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการลด จำนวนชั้นของแกรฟีน

ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินต่อการเกิดของแกรฟิน

จากการสังเคราะห์แกรฟืนบนแผ่นฟอยด์ทองแดงที่อุณหภูมิระหว่าง 900 – 980 $^{\circ}$ C พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืนและอัตราส่วนระหว่าง I_{2D}/I_G พืค จากรามานสเปกตรัมดัง แสดงในภาพที่ 17 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 จากตารางแสดงจำนวนชั้นของแกรฟืนเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืน ซึ่งสามารถยืนยันได้จากอัตราส่วน I_{2D}/I_G พืค และจากภาพที่ 17 พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความเข้มของ D พีค ลดลง และจากตารางที่ 2 ยังพบว่า อัตราส่วน I_{2D}/I_G = 1.12 ยืนยันว่าเป็นแกรฟืนสองชั้น ถึงแม้ว่าจะทำการสังเคราะห์แกรฟืนที่ อุณหภูมิสูงถึง 980 $^{\circ}$ C ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการสังเคราะห์แกรฟืนที่อุณหภูมิสูงช่วยลดจำนวนชั้น และลดข้อบกพร่องในแกรฟืน

หมายเลข	อุณหภูมิ	อัตราใหลของแก๊สมีเทน	ເວລາ	I_{2D}/I_G
ตัวอย่าง	(°C)	(sccm)	(นาที)	
7	900	5	2	0.59
8	950	5	2	0.78
9	980	5	2	1.12

ตารางที่ 2 เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนและอัตราส่วน I_{2D}/I_G พีค จากรามานสเปกตัมของ แกรฟีนตัวอย่างคังแสดงในภาพที่ 17 (Mohsin, 2012)



ภาพที่ 17 รามานสเปกตรัมของแกรฟินตัวอย่างที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ที่อัตราไหลการ ของแก๊สมีเทน 5 secm เป็นเวลา 2 นาที (Mohsin, 2012)

2.5 ผลของความขรุขระของวัสดุรองรับทองแดงต่อการเกิดแกรฟืนโดเมนที่ความดัน บรรยากาศ

จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา กลุ่มนักวิจัยพยายามพัฒนาการสังเคราะห์แกรฟืนบนโลหะ ทรานซิชัน เช่น นิเกิล (Ni) รูทึเนียม (Ru) โมลิบคินัม (Mo) ทองแคง (Cu) และทองคำ (Au) ค้วยวิธี CVD จนประสบความสำเร็จ โดยหมู่โลหะทรานซิชันที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ แกรฟืน ทองแคงแสดงสมบัติที่เหนือกว่าโลหะชนิดอื่น ๆ เนื่องจากทองแคงมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ แกรฟืนที่เกิคบนผิวทองแคงมีความเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถเกลื่อนย้ายแผ่นแกรฟืนออกจากผิว ของทองแดงได้ง่ายเมื่อต้องการนำแกรฟินไปประยุกต์ใช้งาน Wang et al. (2014) ได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับความขรุขระของพื้นผิวและรอยต่อของเกรน (grain boundary) ของทองแดงต่อการเกิด นิวคลีเอชัน (nucleation) ของแกรฟิน โดเมน โดยการควบคุมการเกิดนิวคลีเอชันจากการขัดพื้นผิว ของทองแดงให้เรียบด้วยวิธี Chemical Mechanical Polished (CMP) ทำการสังเคราะห์แกรฟินด้วย วิธี CVD บนฟอยด์ทองแดงที่ผ่านการขัดและไม่ขัดพื้นผิวให้เรียบที่อุณหภูมิ 1050 [°]C โดยใช้แก๊ส มีเทนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน หลังจากนั้นทำการเกลื่อนย้ายแกรฟินออกจากผิวทองแดงไปวางบน ฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ดังแสดงในภาพที่ 18



ภาพที่ 18 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (ก) ทองแคงที่ไม่ผ่านการขัดผิวให้เรียบก่อนการ สังเคราะห์แกรฟีน (ข) ทองแคงที่ผ่านการขัดผิวให้เรียบก่อนการสังเคราะห์แกรฟีน (ก) และ (ง) การเคลื่อนย้ายแกรฟีนวางบนวัสดุรองรับซิลิกอนไดออกไซด์ของแกรฟีน ที่สังเคราะห์บนทองแคงที่ไม่ผ่านและผ่านการขัดผิวให้เรียบตามลำดับ (Wang et al., 2014)

จากภาพที่ 18 (ก) แสดงภาพแผ่นฟอยด์ทองแดงที่ไม่ผ่านการขัดพื้นผิวให้เรียบก่อนทำ การสังเคราะห์แกรฟีน พบว่าพื้นผิวมีรอยหยักและขรุขระ มีจุดบกพร่องบนพื้นผิวของทองแดงเป็น จำนวนมากเมื่อเทียบกับภาพที่ 18 (ข) พื้นผิวของทองแดงเรียบและรอยหยักบนพื้นผิวทองแดงลดลง เนื่องจากทองแดงผ่านการขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยวิธี CMP ภาพที่ 18 (ด) แสดงการเกลื่อนย้ายแกรฟีน ที่สังเคราะห์บนทองแดงที่ไม่ผ่านการขัดพื้นผิวให้เรียบวางบนซิลิกอนไดออกไซด์ พบว่า นิวกลีเอชันของการเกิดแกรฟืนมีการกระจายตัวบนพื้นผิวของทองแดงแบบสุ่ม โดยมีขนาดของ แกรฟืนโดเมนเฉลี่ยประมาณ 5 μm ตรงกันข้ามกับแกรฟืนที่สังเคราะห์บนแผ่นฟอยด์ทองแดงที่ ผ่านการขัดผิวให้เรียบด้วยวิธี CMP และทำการเกลื่อนย้ายชั้นของแกรฟืนวางบน ซิลิกอนไดออกไซด์ดังแสดงในภาพที่ 18 (ง) พบว่าความหนาแน่นของแกรฟืนโดเมนลดลง ขนาด ของแกรฟืนโดเมนเฉลี่ยประมาณ 50 μm แกรฟืนที่สังเคราะห์บนแผ่นฟอยด์ทองแดงที่ผ่านการขัด ผิวให้เรียบด้วยวิธี CMP ไม่แตกหักง่ายหลังจากทำการเคลื่อนย้ายแกรฟืนวางบน ซิลิกอนไดออกไซด์ แต่แกรฟืนที่สังเคราะห์บนฟอยด์ทองแดงที่ไม่ผ่านการขัดผิวให้เรียบเกือบจะ แตกหักหมดหลังจากผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายแกรฟืนวางบนซิลิกอนไดออกไซด์และมี PMMA ตกก้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากผลของรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของทองแดง

2.6 การควบคุมการสังเคราะห์และลักษณะของอนุภาคนาโนของโลหะ

อนุภาคนาโนของโลหะที่มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคในช่วงแคบมีความสำคัญ ทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่มีลักษณะจำเพาะ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (optoelectronics) เซนเซอร์ (sensor) การสังเคราะห์สารเคมี กระบวนการกลั่นน้ำมันและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเป็น ้ต้น การกระจายตัวของขนาดอนุภาคนาโนของโลหะในช่วงแคบมือิทธิพลต่อการเกิดผลทางเคมีที่ พื้นผิว (surface chemical activity) สมบัติทางแม่เหล็กรวมทั้งสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ และจาก ้ข้อมูลที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะให้มีการ กระจายตัวเป็นอนุภาคเดี่ยว ๆ ควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโนของโลหะ (Pt, Rh, Pd, Ir, Au และ Ag) โดยการปรับปรุงกลไกการเกิดของอนุภาคนาโนของโลหะในระหว่างกระบวนการ ้สังเคราะห์ ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายวิธีรวมทั้งวิธี โพลิออล เนื่องจาก Pt. Rb และ Pd เป็น โลหะที่มีสมบัติ โคคเค่นและมีการ ้นำมาประยุกต์ในงานหลากหลายค้าน ปัจจุบันจึงได้รับความสนใจในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ อนุภาคนาโนของ Pt, Rh และ Pd ด้วยวิธีโพลิออล โดยมีการควบคุมขนาด รูปร่างและการกระจาย ตัวของขนาดอนุภากจากการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ (Hei, He, Wang, Liu, & Zhang, 2012) ซึ่งสามารถสรปอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ต่อขนาด และรปร่างของอนภาคนาโนของโลหะได้ดังนี้
อิทธิพลความเข้มข้นของสารตั้งต้น

Hei et al. (2012) ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ Pt, Rh และ Pd ด้วยวิธีโพลิออล โดยใช้ H_PtCl₂, RhCl₃ และ H_PdCl₄ เป็นสารตั้งค้นตามลำคับ ใช้พอลิเมอร์พอลิไวนิลไพโรลิโคน (PVP) เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุมรูปร่างของอนุภาคและใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นตัว รีดิวซ์ สังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะเหล่านี้ที่อุณหภูมิ 190 $^{\circ}$ C โดยควบคุมขนาดของอนุภาค จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้น พบว่า อนุภาคนาโนของ Pt, Rh และ Pd มีการ กระจายตัวของขนาดอนุภาคในช่วงแคบ อนุภาคมีรูปร่างเป็นทรงกลมและยังพบว่าเมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งค้นที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคใหญ่ขึ้น โดยขนาดของ อนุภาครูทิเนียมมีค่าเลลี่ย 2.4 nm, 2.7 nm, 2.9 nm, 3.2 nm, 4.0 nm และ 5.1 nm เมื่อใช้สารละลาย RhCl₃ ในกระบวนการสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 0.1 mM, 0.2 mM, 0.4 mM, 0.8 mM, 1.6 mM และ 3.2 mM ตามลำดับ ขนาดของอนุภาคแพลเลเดียมเฉลี่ย 3.2 nm, 3.3 nm, 4.0 nm, 4.4 nm, 4.8 nm และ 5.3 nm เมื่อใช้สารละลาย H₂PdCl₄ ในกระบวนการสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 0.12 mM, 0.24 mM, 0.48 mM, 0.96 mM, 1.92 mM และ 3.48 mM ตามลำคับและขนาดของอนุภาคเพลทินัม เฉลี่ย 3.2 nm, 4.6 nm, 5.7 nm, 6.1 nm และ 6.4 nm เมื่อใช้สารละลาย H₂PtCl₆ ในกระบวนการ สังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 0.1 mM, 0.3 mM, 0.6 mM, 1.2 mM และ 2.4 mM ตามลำคับ

อิทธิพลของอัตราส่วนความเข้มข้นของโลหะต่อพอลิไวนิลไพโรลิโคน (metal/PVP)

Hei et al. (2012) ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ Pt, Rh และ Pd ด้วยวิธีโพลีออล เพื่อศึกษาผลของปริมาณ PVP ต่อขนาดของอนุภาคนาโนของโลหะจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน กวามเข้มข้นของ Pt/PVP, Rh/PVP และ Pd/PVP ในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ โดยมีการ เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกวามเข้มข้นของ metal/PVP จาก 1:5 ถึง 1:40 M ดังแสดงในภาพที่ 19 พบว่า เมื่อปริมาณ PVP เพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยลดลงในช่วงแรกและหลังจากนั้นขนาดของ อนุภาคเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราส่วนความเข้มข้นของ metal/PVP ที่อัตราส่วน 1:10 เป็น อัตราส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่ออัตราส่วน metal/PVP มากกว่า 1:10 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจนและเมื่ออัตราส่วน metal/PVP ต่ำกว่า 1:10 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการ ลดอัตราส่วนของ metal/PVP



ภาพที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุภาคโลหะและอัตราส่วนของ Pt/PVP, Rh/PVP และ Pd/PVP (Hei et al., 2012)

2.7 เซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่มีความยืดหยุ่นโดยใช้แกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโน แพลเลเดียม

Chung et al. (2012) ทำการสังเคราะห์แกรฟินบนแผ่นฟอยด์ทองแดงหนา 25 µm โดยใช้ วิธี CVD เพื่อนำแกรฟินตัวอย่างมาสร้างเป็นเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนดังแสดงในภาพที่ 20 โดยเริ่ม จากการเคลือบพอลิเมอร์พอลิเมทิลเมทาคริเลตลงบนแกรฟินตัวอย่างที่เคลือบอยู่บนแผ่นฟอยด์ ทองแดงด้วยวิธีปั่นเคลือบ เพื่อรักษาโครงสร้างของแกรฟินในระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย ทำการแยกชั้นของแกรฟินออกจากพื้นผิวของทองแดงโดยใช้ oxygen plasma และต่อมาทำการ กำจัดแผ่นทองแดงออกโดยนำชั้นของ PMMA/graphene/Cu ไปแช่ในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ เหลือชั้นของ PMMA/Graphene ลอยในสารละลาย เมื่อทองแดงถูกกำจัดโดยสมบูรณ์ ทำการ เกลื่อนย้ายชั้น PMMA/graphene มาวางบนวัสดุรองรับพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate, PET) และต่อมาทำการกำจัดชั้นของ PMMA ออก โดยการนำชั้น PMMA/Graphene/PET ไปแช่ในกลอโรฟอร์ม หลังจากนั้นทำการเคลือบแพลเลเดียมที่ความหนา ในช่วง 1- 10 nm ลงบนแกรฟินฟิล์มที่วางอยู่บนวัสดุรองรับ PET ด้วยวิธีไอระเหยทางความร้อน และสุดท้ายทำการเชื่อมต่อลวดทองกำเข้าไปในแกรฟินตัวอย่างโดยใช้กาวเงินเพื่อเป็นขั้วไฟฟ้า สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าและวัดความต่างสักย์ไฟฟ้าในกระบวนการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน



ภาพที่ 20 กระบวนการสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนโคยใช้ฟิล์มแกรฟินที่เคลือบแพลเลเคียม (Chung et al., 2012)

ในงานวิจัยนี้ Chung et al. (2012) สามารถเตรียมแกรฟืนชั้นเดียวบนแผ่นฟอยด์ทองแดง ด้วยวิธี CVD ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการวิเคราะห์อัตราส่วนของ I_{2D}/I_G พีก ด้วยเทกนิก รามานสเปกโตรสโกปีมีก่าเท่ากับ 3.3 ดังแสดงในภาพที่ 21 (ก) และภาพที่ 21 (ข) แสดงกวาม ด้านทานไฟฟ้าเริ่มต้น (R₀) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่สร้างจากแกรฟืนที่มีการเกลือบ แพลเลเดียมที่กวามหนาต่าง ๆ พบว่า กวามต้านทานไฟฟ้าของแกรฟืนลดลงเมื่อกวามหนาของ แพลเลเดียมที่เกลือบบนชั้นของแกรฟืนมีกวามหนาเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 21 (ก) สเปกตรัมรามานของแกรฟืนที่มีการเคลื่อนย้ายไปวางบนวัสดุรองรับ PET และ (ข) แสดงความด้านทานไฟฟ้าเริ่มด้น (R₀) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนจากแกรฟืนที่ เคลือบด้วยแพลเลเดียมที่ความหนาต่าง ๆ (Chung et al., 2012)

ผลจากการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของ Chung et al. (2012) ดังแสดงในภาพที่ 22 การ เปลี่ยนแปลงกวามด้านทานไฟฟ้าของแกรฟีนเมื่อสัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนที่กวามเข้มข้น 1,000 ppm พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกวามด้านทานไฟฟ้าในแกรฟีน แต่แกรฟีนที่มีการเกลือบ ด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมเมื่อสัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนเกิดการเปลี่ยนแปลงกวามด้านทานไฟฟ้า เนื่องจากเมื่อเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนมีการดูดซับโมเลกุลไฮโดรเจน อนุภาคแพลเลเดียมที่อยู่บน แกรฟีนเปลี่ยนเป็นแพลเลเดียมไฮไดรต์ ส่งผลให้พลังงานขีดเริ่ม (Work function) ของแพลเลเดียม ต่ำลงกว่าแพลเลเดียมบริสุทธิ์ ทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเลีกตรอนจากแพลเลเดียมไปยังแกรฟีนเกิด Trap p-type carriers ในแกรฟีนขึ้น ส่งผลทำให้ความด้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจน การตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนเมื่อพิจารณาตามความหนาของแพลเลเดียมที่เกลือบอยู่ บนแกรฟีนดังภาพที่แทรกอยู่ในภาพที่ 22 จะเห็นว่าการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนก่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนถึงก่าสูงสุดประมาณ 32.9 % ในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่เกลือบแพลเลเดียมหนา 3 nm บน แผ่นแกรฟีน สำหรับเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่มีแพลเลเดียมเกลือบอยู่บนแกรฟีนหนามากกว่า 3 nm การตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนลดลง เนื่องจากการนำไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ผ่านทางฟิล์ม แพลเลเดียมก่อนข้างมากกว่าแกรฟีน



ภาพที่ 22 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนแกรฟีน และแกรฟีนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาต่าง ๆ เมื่อสัมผัสกับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 1,000 ppm (Chung et al., 2012)

ภาพที่ 23 (ก) แสดงการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนซ้ำที่ความเข้มข้น 1,000 ppm ใน เซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจนของแกรฟืนที่มีอนุภาคนาโนแพลเลเคียมเคลือบที่ความหนา 3 nm ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าระหว่างรอบการวัคซ้ำมีการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนลุคลงเล็กน้อยและเริ่มอิ่มตัว ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการคืนตัวไม่สมบรณ์ (Recovery) ของแพลเลเคียมไฮไครต์ (PdH) ในขณะที่ ้มีการปล่อยแก๊สไนโตรเจน กระบวนการคืนตัวมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแพลเลเดียม ้ไฮไครต์กลับมาเป็นแพลเลเคียมอีกครั้ง สามารถแก้ไขปัญหาการคืนตัวไม่สมบูรณ์ในเซนเซอร์โคย การนำเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนไปสัมผัสกับโมเลกลของออกซิเจน ซึ่งมีผลต่อการเร่งการคืนตัวของ ้ไฮโครเจนในแพลเลเดียมไฮไครต์โคยการก่อตัวเป็นหม่ไฮครอกซิล (Hydroxyl) และน้ำ เมื่อนำ เซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจนมาใช้งานในบรรยากาศซึ่งมีไอน้ำ เมื่อไอน้ำเกิดการแตกตัวและเกิดการดูค ซับบนพื้นผิวของแพลเลเดียมทำให้ก่อตัวเป็นหมู่ไฮครอกซิล ผลช่วยทำให้เกิดการดูดซับทางเกมี ของอะตอมออกซิเจนขึ้น จากการดูคซับไฮโครเจนเกิคเป็นอะตอมของไฮโครเจนทำให้เกิคปฏิกิริยา ระหว่างไฮโครเจนและหมู่ไฮครอกซิลทำให้เกิดการก่อตัวเป็นน้ำขึ้น เป็นผลทำให้การก่อตัวของ ์แพลเลเดียมไฮไดรต์ลดลง เป็นสาเหตุให้การตอบสนองต่อแก๊สลดลง ภาพที่ 23 (ข) แสดง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าเมื่อเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนสัมผัสแก๊สไฮโครเจน ที่ความเข้มข้น 20 - 1000 ppm ภาพที่ 23 (ค) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อแก๊ส ้ไฮโครเจนกับรากที่สองของความเข้มข้นของไฮโครเจน แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้น เป็นไปตามทฤษฎีการดุดซับของแลงเมียร์ที่อุณหภูมิคงที่ (The Langmuir adsorption isotherm

theory) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการแตกตัวของโมเลกุลไฮโครเจนเป็นอะตอมของไฮโครเจนเมื่อถูกดูค ซับบนพื้นผิวของแพลเลเดียม โคยปฏิกิริยาการแตกตัวของโมเลกุลไฮโครเจนบนพื้นผิวของ แพลเลเดียมสามารถอธิบายได้คังสมการที่ 3

$$H_2 + 2Pd \leftrightarrow 2PdH_x \tag{3}$$

อัตราการดูดซับและการคายไฮโครเจน คือ k₁P(1 – θ)² และ k₋₁θ² เมื่อ k₁ และ k₋₁ คือค่าคงที่การดูดซับและการคายไฮโครเจนตามลำดับ P คือ ความคันของไฮโครเจนและ θ คือ สัคส่วนพื้นผิวของแพลเลเดียมที่ถูกปกคลุมค้วยไฮโครเจนแปรผันกับความไวต่อการตอบสนอง ของไฮโครเจน (ΔR/R₀) ที่สมคุลอัตราการดูดซับไฮโครเจนเท่ากับอัตราการคายไฮโครเจน

$$k_{1}P(1-\theta)^{2} = k_{-1}\theta^{2}$$

$$\frac{\theta}{(1-\theta)} = (k_{1}/k_{-1})^{1/2}P^{1/2}$$
(4)

ที่ความเข้มข้นของไฮโครเจนต่ำ θ ≪ 1 ความไวต่อการตอบสนองของแก๊สไฮโครเจน เป็นสัคส่วนกับรากที่สองของความคันหรือความเข้มข้นของไฮโครเจนเป็นไปตามสมการที่ 5

$$\Delta R/R_0 \propto \theta \approx (k_1/k_{-1})^{1/2} P^{1/2}$$
(5)

เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง (t) มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโครเจนคังแสคงใน ภาพที่ 23 (ง) โดยส่วนกลับของเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง (1/t) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความ เข้มข้นของไฮโครเจนโดยระยะแรกของการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจน อัตราการดูดซับไฮโครเจน คือ k₁P(1 – θ)² เมื่อ (1 – θ)² คือ อัตราส่วนพื้นผิวที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยไฮโครเจนและเนื่องจาก θ มี ค่าน้อย ในระยะแรกอัตราการดูดซับไฮโครเจนมีค่าประมาณ r ~ k₁P ดังนั้นส่วนกลับของเวลาที่ใช้ ในการตอบสนองสอดคล้องกับอัตราการดูดซับไฮโครเจนในช่วงเริ่มต้นของการตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจน อัตราการดูดซับไฮโครเจนมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความเข้มข้นของไฮโครเจน ซึ่ง แสดงให้เห็นว่ากลไกการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์อาศัยกระบวนการแตกตัวโมเลกุล ของแก๊สไฮโครเจนเหนือพื้นผิวแพลเลเดียมเป็นหลัก



ภาพที่ 23 การตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนจากแกรฟีนที่เคลือบด้วยอนุภาค นาโนแพลเลเดียม (ก) การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์เมื่อสัมผัสกับ แก๊ส ไฮโดรเจนที่ความเข้มข้น 1,000 ppm (ข) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทาน ไฟฟ้าเมื่อเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนที่ความเข้มข้น 20 – 1000 ppm (ค) แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อแก๊สและรากที่สองของความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโดรเจน (ง) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการตอบสนองกับความ เข้มข้นของไฮโดรเจน (Chung et al., 2012)

2.8 ผลของขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมไฮบริดกับแกรฟีนต่อ สมบัติการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

Phan and Chung (2014 b) ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยม ไฮบริดกับแกรฟืนเพื่อนำมาตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจน โดยทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ขนาด 25, 40 และ 70 nm ดังแสดงที่ 24 (ก-ค) ต่อมาทำการนำอนุภาคนาโน แพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมมาไฮบริกกับแกรฟืนดังแสดงในภาพที่ 24 (ง-ฉ) เพื่อศึกษาผลของขนาด ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมต่อการตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจน



ภาพที่ 24 ภาพถ่ายจาก SEM ของอนุภาคแพลเลเดียมบริสุทธิ์ที่ขนาด (ก) 25 nm, (ข) 40 nm, (ค) 70 nm และอนุภาคแพลเลเดียมไฮบริดกับแกรฟืน (ง) Pd-Gr-25, (จ) Pd-Gr-40, (ฉ) Pd-Gr-70 (Phan & Chung, 2014 b)

จากการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของ Phan and Chung (2014 b) โดยการนำอนุภาคนาโน แพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ขนาดแตกต่างกันไฮบริดกับแกรฟีน และทำการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนที่กวามเข้มข้นของแก็ส ไฮโดรเจนต่าง ๆ ณ อุณหภูมิห้อง ภาพที่ 25 (ก) แสดงค่าการ ตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโดรเจนในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนที่กวามเข้มข้นไฮโดรเจน 10,000 ppm มีค่า เท่ากับ 2.6 % , 7.9 % และ 17.7 % ในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd-Gr-25, Pd-Gr-40 และ Pd-Gr-70 ตามลำคับ พบว่าขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นง่ายต่อการดูดซับหรือ กายโมเลกุลของไฮโดรเจน ส่งผลทำให้ค่าการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น ภาพที่ 25 (ข) แสดงการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์ที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนต่าง ๆ พบว่า เซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนที่มีขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมต่าง ๆ ไฮบริดกับแกรฟีนมีการ ตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนในช่วงกวามเข้มข้น 10,000 – 10 ppm



ภาพที่ 25 การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนในอนุภาคนาโนแพลเลเดียมรูปทรงสี่เหลี่ยมไฮบริคกับ แกรฟีน ณ อุณหภูมิห้อง ที่ความเข้มข้นไฮโครเจน (ก) 10,000 ppm และ (ข) ที่ความ เข้มข้นไฮโครเจนต่าง ๆ (Phan & Chung, 2014 b)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน

- 3.1.1.1 ท่อควอทซ์ (Quartz tube)
- 3.1.1.2 ภาชนะควอทซ์ (Quartz boat)
- 3.1.1.3 ฟอยด์ทองแดง (Copper foil)
- 3.1.1.4 แก๊สอะเซทิลีน (C2H2 99.6%) (Bangkok Industrial gas Co., LTD)
- 3.1.1.5 แก๊สไฮโดรเจน (H₂) (Bangkok Industrial gas Co., LTD)
- 3.1.1.6 แก๊สอาร์กอน (Ar) (Bangkok Industrial gas Co., LTD)
- 3.1.1.7 อะซิโตน (CH_3COCH_3 95.5%., GR Grade) (Duksan Pure Chemical)
- 3.1.1.8 เอทานอ
ถ $(\mathrm{C_2H_5OH}$ 94.8%., Extra Pure Grade) (Duksan Pure Chemical)
- 3.1.1.9 น้ำกลั้น (DI-water)
- 3.1.1.10 บึกเกอร์
- 3.1.1.11 เครื่องควบคุมอัตราการใหลของแก๊ส (Mass flow controller)

3.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายแกรฟีน

- 3.1.2.1 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (Poly methyl methacrylate, PMMA, M.W. 94,600)
- 3.1.2.2 เฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl₃) (Carlo Erba)
- 3.1.2.3 โทลูอื่น ($C_6H_5CH_3$ 99.5%) (Carlo Erba)
- 3.1.2.4 น้ำกลั่น
- 3.1.2.5 อะซิโตน
- 3.1.2.6 เอทานอล
- 3.1.2.7 กรดไฮโครคลอริก (HCl 37%., AR Grade) (Qrec New Zealand)
- 3.1.2.8 ปีกเกอร์
- 3.1.2.9 ขั้วอิเล็กโทรคบนแผ่น SiO₂/Si
- 3.1.2.10 เครื่อง spin-coating

3.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม

- 3.1.3.1 แพลเลเดียมคลอไรด์ (PdCl₂ \geq 99.9 %) (Sigma Aldrich)
- 3.1.3.2 พอลิไวนิลไพโรลิโดน (Poly vinyl pyrrolidone, PVP, MW 40,000)
- 3.1.3.3 เอทิลีนไกลคอล ($C_6H_6O_2$)
- 3.1.3.4 กรคไฮโครคลอริก
- 3.1.3.5 อะซิโตน
- 3.1.3.6 เอทานอล
- 3.1.3.7 เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge)
- 3.1.3.8 ปีกเกอร์
- 3.1.3.9 แก้สไนโครเจน (N2) (Bangkok Industrial gas Co., LTD)

3.1.4 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

- 3.1.4.1 แก๊สไฮโครเจน
- 3.1.4.2 อากาศแห้ง (Dry air)
- 3.1.4.3 แก๊สในโตรเจน
- 3.1.4.4 มักติมิเตอร์ (Fluke 189)
- 3.1.4.5 คอมพิวเตอร์
- 3.1.4.6 เครื่องควบคุมอัตราการใหลของแก๊ส
- 3.1.4.7 เครื่องควบคุมระบบให้ความร้อน

3.2 การสังเคราะห์แกรฟีน

งานวิจัยนี้ ทำการสังเคราะห์แกรฟินบนแผ่นฟอยค์ทองแคงหนา 50 μm ด้วยวิธี CVD ภายใต้ความคันบรรยากาศ โคยใช้แก๊สอะเซทิลีนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน มีแก๊สอาร์กอนและแก๊ส ไฮโครเจนเป็นแก๊สพาหะ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.2.1 ตัดแผ่นทองแดงขนาด 1 × 4 cm² และนำแผ่นทองแดงมาทำความสะอาดด้วย เครื่องอัลตร้าโซนิกในสารละลายอะซิโตน แอลกอฮอล์และน้ำกลั่นอย่างละ 5 นาที ตามลำดับ เป่า ให้แห้งโดยใช้แก๊สอาร์กอน

3.2.2 นำแผ่นทองแดงวางบนภาชนะควอทซ์ แล้วนำเข้าไปภายในท่อควอทซ์ที่อยู่ภายใน ระบบ CVD ดังแสดงในภาพที่ 26

3.2.3 ทำการให้ความร้อนแก่ระบบ ภายใต้การไหลของแก๊สอาร์กอนที่อัตราการไหล300 sccm

3.2.4 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 850 ⁶C ทำการปล่อยแก๊สอาร์กอนและแก๊สไฮโครเจนที่ อัตราการไหล 300 sccm และ 30 sccm ตามลำคับ เป็นเวลา 15 นาที เพื่อไล่ชั้นออกไซค์ที่อยู่บนผิว ของทองแคง เพิ่มขนาคของเกรน (Grain size) และลครอยต่อของเกรน (Grain boundary) ของผลึก ทองแคง

3.2.5 ปีคแก๊สไฮโครเจน ทำการปล่อยแก๊สอาร์กอนที่อัตราการไหล 300 sccm และแก๊ส อะเซทิลีน (C₂H₂) ที่อัตราไหล 17 sccm เป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำการสังเคราะห์แกรฟีน

3.2.6 ปิดแก๊สอะเซทิลีนและปิดระบบให้ความร้อน ทำการปล่อยแก๊สอาร์กอนที่อัตรา การใหล 300 sccm จนระบบเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง ทำการปิดแก๊สทุกชนิด นำแกรฟินตัวอย่าง ออกจากท่อควอทซ์

3.2.7 ทำการทดลองซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวมา โดยทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์ในขั้นตอน
 ที่ 3.2.4 และ 3.2.5 ดังตารางที่ 3



ภาพที่ 26 ระบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน

ตัวอย่าง	อุณหภูมิที่ใช้ในการ	อัตราการใหลของแก๊ส	เวลาที่ใช้ในการ
	สังเคราะห์แกรฟีน (°C)	อะเซทิลีน (sccm)	สังเคราะห์แกรฟีน (นาที)
1	850	17	5
2	850	17	7
3	850	17	10
4	880	17	5
5	880	17	7
6	880	17	10

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน

3.3 การเคลื่อนย้ายแกรฟีน

ตัดแกรฟีนบนแผ่นฟอยด์ทองแดง (Graphene/Cu) ขนาด 0.6 × 0.8 cm² ทำการ เคลื่อนย้ายแกรฟีนไปวางบนขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si ดังกระบวนการที่แสดงในภาพที่ 27 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.3.1 เตรียมสารละลายพอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) 120 mg ในโทลูอีน 3 mL กวน เป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง

3.3.2 เกลือบ PMMA 5 μL ถงบนชั้น Graphene/Cu โดยเทกนิกปั่นเกลือบ ที่อัตราเร็ว
 2500 rpm จะ ได้ชั้นของ PMMA/Graphene/Cu

3.3.3 ทำการกำจัดชั้น Cu ออกจากชั้น PMMA/Graphene/Cu โดยการนำไปลอยใน สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์เป็นเวลา 120 นาที จะได้ชั้น PMMA/Graphene

3.3.4 ทำการย้ายชั้น PMMA/Graphene ไปลอยในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 2 % เป็นเวลา 10 นาทีโดยใช้กระจกนาฬิกา เพื่อล้างสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ตกค้างออก

3.3.5 ล้างชั้น PMMA/Graphene โดยน้ำกลั่นหลาย ๆ รอบ จนค่า pH เป็นกลาง และทำ การเคลื่อนย้ายไปวางบนขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO,/Si จะได้ชั้น PMMA/Graphene/SiO,/Si

3.3.6 ทำการกำจัดชั้น PMMA ออกจากชั้น PMMA/Graphene/SiO₂/Si โดยการนำเอา ตัวอย่างไปแช่ในอะซีโตนที่อุณภูมิ 70 °C เป็นเวลา 60 นาที ทำให้ได้ชั้นของ Graphene บนขั้ว อิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si



ภาพที่ 27 กระบวนการเคลื่อนย้ายแกรฟีนจากแผ่นฟอยค์ทองแคงไปวางบนขั้วอิเล็กโทรดบน แผ่น SiO2/Si

3.4 การสังเคราะห่อนุภาคนาโนแพลเลเดียม

สังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเคียมด้วยวิธีโพลิออล โดยใช้แพลเลเดียมคลอไรด์ (PdCl₂) เป็นสารตั้งต้น พอลิเมอร์พอลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุม รูปร่างของอนุภาค และใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นทั้งตัวรีดิวซ์และตัวทำละลาย ดังกระบวนการที่แสดง ในภาพที่ 28 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.4.1 ขั้นตอนแรกทำการหยุดกรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 1 ml ลง ใน 0.06 g ของแพลเลเดียมคลอไรด์ กวนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

3.4.2 เติมสารละลาย 0.375 g ของพอลิไวนิลไพโรลิโคนใน 90 ml ของเอทิลีนไกลคอล ลงไป กวนสารละลายจนเป็นเนื้อเคียวกัน

3.4.3 นำสารละลายผสมไปรีฟลักซ์ (reflux) และกวนที่อุณหภูมิ 125 ℃ เป็นเวลา 90 นาที

3.4.4 ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ได้สารแขวนลอยสีดำ แล้วนำสารละลายไปล้างด้วย อะซิโตนหลาย ๆ รอบ ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge)

3.4.5 นำผงตะกอนที่ได้ เป่าให้แห้งด้วยแก๊สในโตรเจน

3.4.6 นำผงตะกอนที่ได้ละลายในเอทานอล 15 ml จะได้สารละลายของแพลเลเดียม

3.4.7 ทำการทดลองซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวมา โดยทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์ในขั้นตอน
 ที่ 3.4.1 ดังตารางที่ 4



ภาพที่ 28 กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลีออล

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม

ตัวอย่าง	ปริมาณแพลเลเดียม	อุณหภูมิในการรีฟลักซ์	เวลาในการรีฟลักซ์
	คลอไรด์ (g)	(°C)	(นาที)
A1	0.06	125	90
A2	0.2	125	90
A3	0.4	125	90
A4	0.6	125	90

3.5 กระบวนการเตรียมเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน

กระบวนการเตรียมเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืน (Pd-NP/Gr) สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 29 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลัก ๆ คือ สังเคราะห์แกรฟืนบนแผ่นฟอยด์ทองแดง การเคลื่อนย้ายแกรฟืนไปวางบน ขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si และการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียมลงบนแกรฟืน สำหรับ ขั้นตอนแรกคือการสังเคราะห์แกรฟืนลงบนแผ่นฟอยด์ทองแดงด้วยวิธี CVD หลังจากการ สังเคราะห์แกรฟืนเสร็จสมบูรณ์ ทำการเคลือบ PMMA ลงบนชั้นของ Gr/Cu ด้วยวิธีปั่นเคลือบเพื่อ รักษาโครงสร้างของแกรฟืนในระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายแกรฟืน ทำการกำจัดชั้นของ ทองแดงออกโดยการนำชั้นของ PMMA/Gr/Cu ไปลอยในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ เมื่อทำการ กำจัดทองแดงเสร็จสมบูรณ์ เคลื่อนย้ายชั้นของ PMMA/Gr ไปวางบนชั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si ตามด้วยการกำจัด PMMA โดยการนำชั้นของ PMMA/Gr/SiO₂/Si ไปแช่ในอะซิโตน ทำให้ได้ชั้น ฟิล์มของ Gr/SiO₂/Si บนขั้วอิเล็กโทรดที่สมบูรณ์ สุดท้ายทำการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ลงบนแกรฟืนที่ปริมาตรสารละลายแพลเลเดียม 50, 100, 150, 200 และ 250 µl ด้วยวิธีปั่นเคลือบที่ อัตราเร็ว 1,000 rpm



ภาพที่ 29 กระบวนการสร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนา โนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน

3.6 การตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

วางเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจน Pd-NP/Gr ภายในระบบตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนดังแสดงใน ภาพที่ 30 โดยทำการวัดการเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าด้วยวิธี 2 โพรบ ด้วยมัลติมิเตอร์ (Fluke 189) ขั้นตอนแรกทำการปล่อยแก๊ส ในโตรเจนที่อัตราการ ไหล 1,000 sccm เป็นเวลา 5 นาที เพื่อวัดความด้านทานไฟฟ้าเริ่มด้น ต่อมาทำการปล่อยแก็ส ไฮโดรเจนภายใต้การเจือจางด้วยแก๊ส ในโตรเจนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เข้าไปภายในระบบเป็นเวลา 30 นาที เพื่อวัดสัญญานการ เปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้า หลังจากนั้นทำการปิดแก๊ส ไฮโดรเจนและแก๊ส ไนโตรเจน ทำการ ให้ความร้อนแก่ระบบที่อุณหภูมิ 90 °C ภายใต้การไหลของอากาศแห้ง (dry air) ที่อัตราการไหล 1,000 sccm เป็นเวลา 10 นาที เพื่อกำจัดโมเลกุลของไฮโดรเจนที่ถูกดูดซับในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนออก สุดท้ายปล่อยให้ระบบเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องภายใต้การไหลของแก๊สไนโตรเจนที่ อัตราการไหล 1,500 sccm เป็นเวลา 45 นาที



ภาพที่ 30 ระบบตรวจวัคแก๊สไฮโครเจน

3.7 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะตัวอย่าง

ยืนยันความเป็นแกรฟินด้วยรามานสเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy) วิเคราะห์ ลักษณะพื้นผิวของแกรฟินและแกรฟินที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM, ยี่ห้อ LEO รุ่น LEO 1450 VP) ศึกษาโครงสร้างของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron microscopy, TEM, ยี่ห้อ Philips รุ่น TECNAI 20) วิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนด้วย Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDX) และวัดการ เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนด้วยวิธี 2 โพรบ โดยใช้มัลติมิเตอร์ (Fluke 189)

บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 ผลการศึกษาลักษณะของแกรฟืน

้งากการสังเคราะห์แกรฟืนด้วยวิธี CVD บนแผ่นฟอยด์ทองแดง โดยใช้แก๊สอะเซทิลีน ้เป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน มีแก๊สอาร์กอนและแก๊สไฮโครเจนเป็นแก๊สพาหะ ทำการศึกษาผลของ เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืนต่อการเกิดของแกรฟืน โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค รามานสเปกโตรสโกปีดังแสดงในภาพที่ 31 เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน อัตราส่วนความ เข้มของ 2D พีก ต่อ G พีก (I_{2p}/I_{G} ratio) และความเข้มของ D พีก สรุปได้ดังตารางที่ 5 จาก ้สเปกตรัมรามานดังแสดงในภาพที่ 31 ปรากฏพืกที่สำคัญ 3 พืก คือ D, G และ 2D พึก ที่ตำแหน่ง ประมาณ 1,345 cm⁻¹, 1,587 cm⁻¹ และ 2,700 cm⁻¹ ตามลำดับ โดย D พีค แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ ้ของแผ่นแกร ไฟต์และคาร์บอนที่ไม่เป็นระเบียบที่เจือปนอยู่ G พีค แสดงถึงความเป็นระเบียบและ ้ความบริสุทธิ์ของแผ่นแกร ไฟต์และ 2D พืค แสดงถึงลักษณะของแกรฟืน ซึ่งจำนวนชั้นของแกรฟืน ้สามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนความเข้มของ ${
m I}_{
m 2p}/{
m I}_{
m G}$ และจากตารางที่ 5 พบว่า แกรฟืนที่เตรียมได้ ในทุกเงื่อนไขเป็นแกรฟีนหลายชั้น ยืนยันได้จากอัตราส่วนของ $\mathbf{I}_{2D}/\mathbf{I}_{G}$ มีค่าน้อยกว่า 1 (Nguyen et al., 2013) โดยที่อัตราส่วน I_{2D}/I_G พีก ลดลงเมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืน ้เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั้นของแกรฟีนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟินน้อย เป็นตัวแปรที่สำคัญในการลคจำนวน ้ชั้นของแกรฟีน และในกรณีที่ทำการสังเคราะห์แกรฟีนที่อุณหภูมิ 880 °C ที่เวลาต่าง ๆ ภายใต้อัตรา การ ใหลของแก๊สอะเซทิลีนเคียวกัน พบว่าความเข้มของ D พีค ลคลง เมื่อเวลาที่ใช้ในการปลก แกรฟีนน้อยลง แสดงให้เห็นว่า ข้อบกพร่องในโครงสร้างของแกรฟีนลดลง เมื่อเวลาที่ใช้ในการ ้สังเคราะห์แกรฟีนน้อยลง แต่ในกรณีที่ทำการสังเคราะห์แกรฟีนที่อุณหภูมิ 850 °C ที่เวลาต่าง ๆ ภายใต้อัตราการไหลของแก๊สอะเซทิลีนเดียวกัน ไม่สามารถอธิบายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นใน ้โครงสร้างของแกรฟืนที่ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟืนได้ คาดว่าการแตกตัวของแก๊ส ้อะเซทีลีนที่อุณหภูมิ 850 [°]C ยังไม่สมบูรณ์พอ ทำให้การตกเคลือบของอะตอมคาร์บอนบนแผ่น ทองแคงไม่สมบรณ์ ส่งผลให้โครงสร้างของแกรฟีนเกิคความไม่เสถียร จึงสามารถสรปได้ว่า ้อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนสูงขึ้น ส่งผลทำให้โครงสร้างของแกรฟีนมีความเสถียรและมี ้ความสมบรณ์มากขึ้น (Kim et al., 2012) ในงานวิจัยนี้นำแกรฟืนที่เงื่อนไขการสังเคราะห์ที่อณหภมิ 880 [°]C และเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน 5 นาที มาเป็นองค์ประกอบในเซนเซอร์แก๊ส

ไฮโครเจน เนื่องจากแกรฟืนที่เงื่อนไขคังกล่าวมีความสมบูรณ์มากที่สุด ยืนยันได้จากก่าความเข้ม ของ D พีก ต่ำสุด โดยมีก่ากวามเข้มของ D พีก ประมาณ 50,306 เมื่อเทียบกับแกรฟืนที่สังเคราะห์ที่ เงื่อนไขอื่น



- ภาพที่ 31 รามานสเปกตรัมของแกรฟืนที่สังเคราะห์บนแผ่นฟอยค์ทองแคงที่อุณหภูมิ (ก) 850 °C และ (ข) 880 °C
- ตารางที่ 5 เงื่อนไขที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีน อัตราส่วนของ I_{2D} / I_G พีค และความเข้มของ D พีค จากรามานสเปกตรัมของแกรฟีนดังภาพที่ 31

ตัวอย่าง	อุณหภูมิที่ใช้ในการ	อัตราไหลของ	เวลาที่ใช้ในการ	I2D/Ic	ความเข้ม
	สังเคราะห์แกรฟีน	แก๊สอะเซทิลีน	สังเคราะห์แกรฟีน	-2D7 -G	ของ D พิก
	(°C)	(sccm)	(นาที)		
1	850	17	5	0.85	217,324
2	850	17	7	0.73	65,969
3	850	17	10	0.24	266,156
4	880	17	5	0.68	50,306
5	880	17	7	0.39	103,507
6	880	17	10	0.05	813,634

4.2 ผลการศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม

้จากการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลิออล โดยใช้แพลเลเดียมคลอไรด์ เป็นสารตั้งต้น พลลิเมอร์พอลิไวนิลไพโรลิโคนเป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุมรูปร่างของ ้อนุภาค ใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นทั้งตัวรีดิวซ์และตัวทำละลาย โดยควบคุมขนาดของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรด์ ดังนี้ 0.06 g, 0.2 g, 0.4 g และ 0.6 g ทำการวิเคราะห์รูปร่างและขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยภาพถ่ายจาก TEM ดัง แสดงในภาพที่ 32 (ก-ง) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกระจายตัวแบบเกาส์ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ้ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมคังแสคงในภาพที่ 33 (ก-ง) พบว่า เงื่อนไขที่ใช้แพลเลเดียมคลอไรด์ 0.06 g ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมดังภาพที่ 32 (ก) รูปร่างของอนุภาคนาโน ์ แพลเลเคียมเป็นรูปทรงกลมและทรงหกเหลี่ยม โคยส่วนใหญ่ขนาคเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค กระจายตัวอยู่ในช่วงตั้งแต่ 7 nm ถึง 8 nm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 7.7 ± 1.2 nm ดังแสดงในภาพที่ 33 (ก) เงื่อนไขที่ใช้แพลเลเดียมคลอไรด์ 0.2 g ในการสังเคราะห์ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมดังภาพที่ 32 (ข) รูปร่างของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมเป็นรูปทรงกลม ทรง หกเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยม โดยส่วนใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคกระจายตัวอยู่ในช่วง ์ ตั้งแต่ 9 nm ถึง 11 nm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของอนภาคประมาณ 10.1 ± 0.19 nm คัง แสดงในภาพที่ 33 (ง) เงื่อนไขที่ใช้แพลเลเดียมคลอไรด์ 0.4 g ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน แพลเลเคียมคังภาพที่ 32 (ค) รูปร่างของอนุภาคนาโนแพลเลเคียมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทรงหก ้เหลี่ยมและทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคกระจายตัวอยู่ในช่วง ์ ตั้งแต่ 10 nm ถึง 12 nm มีขนาดเส้นผ่านศนย์กลางเฉลี่ยของอนภาคประมาณ 11.1 ± 0.02 nm ดัง แสดงในภาพที่ 33 (ก) และที่เงื่อนไขที่ใช้แพลเลเดียมกลอไรด์ 0.6 g ในการสังเกราะห์อนภาคนาโน แพลเลเดียมดังภาพที่ 32 (ง) รูปร่างของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทรงหก ้เหลี่ยมและทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคกระจายตัวอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 11nm ถึง 13 nm และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของอนุภากประมาณ 12 ± 0.12 nm คัง แสดงในภาพที่ 33 (ง) ซึ่งสามารถสรปได้ว่า ขนาดเส้นผ่านศนย์กลางเฉลี่ยของอนภาคนาโน ์ แพลเลเดียมเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณแพลเลเดียมคลอไรด์ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อนภาคเพิ่มขึ้น โดยอนภากนาโนแพลเลเดียมมีขนาดเส้นผ่านศนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 7,7 nm, 10.1 nm, 11.1 nm และ 12.0 nm เมื่อใช้สารตั้งต้นแพลเลเดียมคลอไรด์ในกระบวนการสังเคราะห์ที่ปริมาณ 0.06 g. 0.2 g, 0.4 g และ 0.6 g ตามลำคับ



ภาพที่ 32 ภาพถ่ายจาก TEM ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโพลีออล ควบคุม ขนาดของอนุภาคจากปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรด์ (ก) 0.06 g, (ข) 0.2 g, (ค) 0.4 g และ (ง) 0.6 g



ภาพที่ 33 การกระจายตัวแบบเกาส์ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ที่สัมพันธ์กับภาพถ่าย TEM ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมดังแสดงในภาพที่ 32 โดยใช้ แพลเลเดียมคลอไรด์ (ก) 0.06 g, (ข) 0.2 g, (ก) 0.4 g และ (ง) 0.6 g ในการสังเคราะห์

4.3 ผลของปริมาตรสารละลายแพลเลเดียมต่อความหนาแน่นของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน

จากการศึกษาผลของปริมาตรสารละลายแพลเลเดียมต่อความหนาแน่นของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืน เพื่อนำแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาแน่น ต่าง ๆ มาทำการศึกษาการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน โดยนำผงของแพลเลเดียมที่มีขนาคเส้นผ่าน ศูนย์กลางของอนุภาคขนาค 11.1 nm ละลายใน 15 ml ของเอทานอล และนำสารละลายแพลเลเดียม เคลือบลงบนแผ่นแกรฟืนขนาค 0.6 × 0.8 cm² ที่วางบนขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si ด้วยวิธีปั่น เกลือบที่อัตราเร็ว 1,000 rpm โดยควบคุมความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่กระจายตัว บนแผ่นแกรฟืนจากการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตรสารละลาย 50 μl, 100 μl, 150 μl, 200 μl และ 250 μl ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมที่กระจายตัวบนแผ่นแกรฟืนด้วยภาพถ่ายจาก SEM ที่ขนาดพื้นที่ 4,471 μm² ดังแสดง ในภาพที่ 34 (ก-จ) พบว่า เมื่อเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตรสูงขึ้น ความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่กระจายตัวบนแผ่นแกรฟืนเพิ่มขึ้น ความหนาแน่น ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมต่อหน่วยพื้นที่สรุปได้ดังตารางที่ 6



ภาพที่ 34 ภาพถ่ายจาก SEM แสดงการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนที่ ความหนาแน่นต่าง ๆ เมื่อทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ ปริมาตรสารละลาย (ก) 50 µl, (ข) 100 µl, (ค) 150 µl, (ง) 200 µl และ (จ) 250 µl

ปริมาณสารละลายแพลเลเคียม (μ1)		ความหนาแน่นของอนุภาคต่อหน่วยพื้นที่	
		(อนุภาค / 4,471 µm ²)	
	50	$5.8 \times 10^{-3} \pm 0.2 \times 10^{-3}$	
	100	$8 \times 10^{-3} \pm 0.6 \times 10^{-3}$	
	150	$11.1 \times 10^{-3} \pm 0.4 \times 10^{-3}$	
	200	$14.7 \times 10^{-3} \pm 0.6 \times 10^{-3}$	
	250	$17.6 \times 10^{-3} \pm 1.5 \times 10^{-3}$	

ตารางที่ 6 สรุปความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมต่อหน่วยพื้นที่จากการวิเคราะห์ด้วย ภาพถ่ายจาก SEM ดังภาพที่ 34

4.4 องค์ประกอบของธาตุของแกรฟีนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียม

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุของแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียม วางบนขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si ด้วยสเปกตรัม EDX ดังแสดงในภาพที่ 35 พบว่า ปรากฏพีค ของธาตุการ์บอนและแพลเลเดียม ยืนยันได้ว่าเกิดจากผลของแกรฟืนและอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ในส่วนของพีกที่มีความเข้มสูงนั้นเป็นพีกของซิลิกอนที่ใช้เป็นวัสดุรองรับ



ภาพที่ 35 สเปกตรัม EDX ของแผ่นแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมวางบนขั้ว อิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si

4.5 ผลการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

จากการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลอออลและทำการควบคุมขนาด ของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรด์ ผลจากการ ทดลองดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมมีขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางเฉลี่ย ประมาณ 7.7 nm, 10.1 nm, 11.1 nm และ 12.0 nm เมื่อใช้สารตั้งด้นแพลเลเดียมคลอไรด์ ใน กระบวนการสังเคราะห์ที่ปริมาณ 0.06 g, 0.2 g, 0.4 g และ 0.6 g ตามดำดับ นำผงของแพลเลเดียมที่ มีขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางของอนุภาคขนาดต่าง ๆ ละลายใน 15 ml ของเอทานอล ต่อมานำ สารละลายแพลเลเดียมที่มีขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางของอนุภาคขนาด 7.7 nm, 10.1 nm, 11.1 nm และ 12.0 nm เกลือบลงบนแผ่นแกรฟันขนาด 0.6 × 0.8 cm² ที่วางบนขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่น SiO₂/Si และตั้งชื่อเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนเป็น Pd-NP/Gr -7.7, Pd-NP/Gr -10.1, Pd-NP/Gr -11.1 และ Pd-NP/Gr -12 ตามลำดับ ทำการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนในเซนเซอร์ เพื่อศึกษาผลของขนาดและ ความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟันต่อความสามารถในการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจน และเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนนต่อการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน โดยก่าการตอบสนองค่อแก๊สไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนนิยามได้จากเปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้า (ΔR/R₀%) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนเมื่อสัมผัสกับแก๊สต่างๆ ดังสมการที่ (6)

Gas response % =
$$\Delta R/R_0$$
 % = (($R_g - R_0$)/ R_0) × 100 (6)

เมื่อ R_o คือ ความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้นของเซนเซอร์ขณะสัมผัสกับแก๊สไนโตรเจนหรือ อากาศแห้ง และ R_g คือ ความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์ขณะสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจน

4.5.1 ผลของขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมต่อการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

จากการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd-NP/Gr -7.7, Pd-NP/Gr -10.1, Pd-NP/Gr -11.1 และ Pd-NP/Gr -12 โดยทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมใน แต่ละเงื่อนไขที่ปริมาตร 100 μl ลงบนแผ่นแกรฟืนดังแสดงในภาพที่ 36 (ก-ง) โดยทำการตรวจวัด แก๊สไฮโดรเจนซ้ำ 3 ครั้ง ที่ความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจน 6,000 ppm ณ อุณหภูมิห้อง พบว่า หลังจากเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจน เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของ เซนเซอร์เพิ่มขึ้นทุกรอบที่ทำการตรวจวัดซ้ำสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้ามีก่าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.74%, 0.89%, 2.26% ในเซนเซอร์ที่เคลือบ ด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ย 7.7 nm (Pd-NP/Gr -7.7), 10.1 nm (Pd-NP/Gr -10.1) และ 11.1 nm (Pd-NP/Gr -11.1) ลงบนแผ่นแกรฟืนตามลำดับ ซึ่ง ้สามารถสรุปได้ว่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้ามีก่าเพิ่มขึ้นจนถึงก่าสูงสุด ประมาณ 2.26% ในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr -11.1 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่คีในการปรับปรุงค่า การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มหรือถดความหนาแน่นของอนภาคนาโน ้แพลเลเดียมที่กระจายตัวบนแผ่นแกรฟีนต่อไป เนื่องจากเมื่อทำการเกลือบอนภากนาโนแพลเลเดียม ้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ยมากกว่า 11.1 nm ลงบนแผ่นแกรฟิน ค่าเปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้ามีค่าลดลง ดังเช่นในกรณีที่มีการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ย 12 nm (Pd-NP/Gr -12) ลงบนแผ่นแกรฟืนมีค่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าประมาณ 1.82 % คาดว่าเป็นผลมาจากขนาดของ ้อนุภากที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของอนุภากนาโนแพลเลเดียมลดลง ส่งผลทำให้ พื้นที่ผิวในการดูคซับโมเลกูลของแก๊สไฮโครเจนลคลง (Phan & Chung, 2014 c) และจากภาพยัง พบว่าหลังจากที่ให้ความร้อนแก่ระบบที่อุณหภูมิ 90 ⁶C ภายใต้การไหลของอากาศแห้ง (Dry air) ใน กระบวนการการคืนตัว (recovery process) เพื่อกำจัดโมเลกลของไฮโดรเจนที่ถูกคุดซับในเซนเซอร์ แก๊สไฮโครเจนออก ความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้น (R.) ลคลงจากเคิมเล็กน้อยในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจน Pd-NP/Gr -7.7, Pd-NP/Gr -10.1 และ Pd-NP/Gr -11.1 และความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้น ้ถุดลงอย่างรุนแรงในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr -12 คาดว่าเป็นผลมาจากการตกค้างของ สารละลายของ PVP ที่ใช้เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุมรูปร่างของอนุภาคในกระบวนการ ้สังเคราะห์อนภาคนาโนแพลเลเดียม เมื่อทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟีน อาจทำให้เกิดการเคลือบสารละลาย PVP ลงบนเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วย ส่งผลทำให้การ ้เชื่อมต่อระหว่างอนุภาคนาโนแพลเลเคียมแต่ละอนุภาคและการเชื่อมต่อระหว่างอนุภาคนาโน แพลเลเดียมกับแกรฟีนแน่นเกินไป เพราะฉะนั้นในระหว่างกระบวนการคืนตัวที่มีการให้ความร้อน แก่ระบบ ผลของความร้อนอาจส่งผลทำให้เกิดการการอ่อนตัวของ PVP ที่เคลือบบนเซนเซอร์แก็ส ้ไฮโครเจนทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอนุภาคนาโนแพลเลเคียมสองอนุภากที่อยู่ใกล้กันและการ เชื่อมระหว่างอนุภาคนาโนแพลเลเดียมกับแกรฟืนเกิดการคลายตัว ส่งผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้า ี้เริ่มต้นลดลงจากเดิม ดังรายงานการวิจัยของ Weiß et al. (2015) ได้กล่าวว่า สารละลาย PVP ที่ใช้ เป็นสารลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์ลวดนาโนของเงิน (Silver nanowires) ส่งผลกระทบด้านลบ ต่อการทำงานของขั้วไฟฟ้าที่มีฟิล์มบางของลวคนาโนของเงินเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากเปลือกที่ เป็นฉนวนของพอถิเมอร์ที่ห่อหุ้มถวคนาโนของเงินทำให้การเชื่อมต่อระหว่างถวคนาโนแต่ละเส้น และการเชื่อมต่อระหว่างลวดนาโนกับวัสดุรองรับแน่นเกินไป ส่งผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้าใน

สองมิติหรือแผ่น (Sheet resistance) เพิ่มขึ้นในขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของลวคนาโนของเงิน แต่หลังจาก ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของลวคนาโนของเงินผ่านการทรีตเมนต์ด้วยกวามร้อนที่อุณหภูมิ 60 °C กวาม ด้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าลคลง เนื่องจากกวามร้อนทำให้พอลิเมอร์เกิดการอ่อนตัว ส่งผลให้ กวามด้านทานไฟฟ้าระหว่างผิวสัมผัสที่มีการเชื่อมต่อ (Contact resistance) ลดลง



ภาพที่ 36 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน (ก) Pd-NP/Gr -7.7, (ข) Pd-NP/Gr -10.1, (ค) Pd-NP/Gr -11.1 และ (ง) Pd-NP/Gr -12 เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ที่อุณหภูมิห้อง

กล ใกการตรวจวัดแก๊ส ไฮ โครเจนในเซนเซอร์แก๊ส ไฮ โครเจน Pd-NP/Gr สามารถอธิบาย ใค้จากความแตกต่างของฟังก์ชันงาน (work function) ระหว่างแพลเลเดียมและแกรฟีน โคยทั่วไป ความแตกต่างของฟังก์ชันงานระหว่าง โลหะและแกรฟีนส่งผลทำให้เกิดการเลื่อนของพลังงานที่ ระดับเฟอร์มิ (Fermi level) ออกจากจุคดิเรก (Dirac points) ของแกรฟีน ส่งผลทำให้เกิดการเจือ อิเล็กตรอน (-) หรือ โฮล (+) ในโครงสร้างของแกรฟีน ดังนั้นการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ลงบนแผ่นแกรฟีนจะเกิดการถ่าย โอนอิเล็กตรอนจากแกรฟีน ไปยังอนุภาคนาโนแพลเลเดียม เนื่องจากแกรฟินมีค่าฟังก์ชันงาน (W_G) ประมาณ 4.5 eV ซึ่งต่ำกว่าฟังก์ชันงานของแพลเลเดียม (W_{Pd}) มีค่าประมาณ 5.6 eV ทำให้เกิดการเจือของโฮลในโครงสร้างของแกรฟินดังแสดงในภาพที่ 37 (ก) แต่หลังจากเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd- NP/Gr สัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจน แพลเลเดียมจะ เปลี่ยนเป็นแพลเลเดียมไฮไดรด์ (PdH_x) ซึ่งแพลเลเดียมไฮไดรด์มีค่าฟังก์ชันงานต่ำกว่าแพลเลเดียม บริสุทธิ์และแกรฟิน ทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากแพลเลเดียมไฮไดรด์ไปยังแกรฟิน ส่งผล ทำให้จำนวนโฮลที่เป็นพาหะการนำไฟฟ้าในโครงสร้างของแกรฟินลดลงดังแสดงในภาพที่ 37 (ข) จึงส่งผลทำให้ความด้านทานไฟฟ้าในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นในระหว่างสัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจน (Kumar, Malik, & Mehta, 2015)



ภาพที่ 37 แถบพลังงานของแกรฟืนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียม (ก) ก่อน และ (ข) หลัง สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจน

4.5.2 ผลความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีนต่อการตรวจวัด แก๊สไฮโดรเจน

ผลจากการตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจนในเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจนที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโน แพลเลเดียมที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.1 nm (Pd-NP/Gr-11.1) โดยควบคุมความหนาแน่นจาก ปริมาตรของสารละลายแพลเลเดียมที่เคลือบลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตร 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl และ 250 µl เมื่อนำมาทำการตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจนซ้ำ 3 ครั้ง ที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ณ อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพที่ 38 พบว่า เมื่อเซนเซอร์ที่เคลือบด้วยอนภาคนาโนแพลเลเดียมที่ ้ความหนาแน่นต่าง ๆ สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจน เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า ้เพิ่มขึ้นทุกตัวอย่างและทุกรอบที่ทำการตรวจวัคซ้ำแต่ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน ้ไฟฟ้าแตกต่างกันในแต่ละตัวอย่าง โดยค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้ามี ้ค่าประมาณ 1.57%, 2.26%, 2.77%, 3.90 % และ 1.78% ของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่เคลือบ สารละลายแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตร 50 แl, 100 แl, 150 แl, 200 แl และ 250 แl ้ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าก่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึง ้ ค่าสูงสุดประมาณ 3.90 % ในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 200 µ1 ลงบนแผ่นแกรฟินและหลังจากเคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตรมากกว่า 200 µ1 ลง ้บนแผ่นแกรฟีนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าลุดลง เช่น ในกรณีเซนเซอร์แก๊ส ้ไฮโครเจนที่เคลือบสารละลายแพลเลเคียมที่ปริมาตร 250 แ1 ลงบนแผ่นแกรฟืน ซึ่งสามารถสรปได้ ้ว่า การกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟืนที่ความหนาแน่นระดับปานกลางมี ้ความสามารถในการตรวจวัคแก๊สไฮโครเจนได้ดีที่สุด การกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ที่ความหนาแน่นน้อยหรือมากบนแผ่นแกรฟีนไม่ใช่เงือนไขที่มีความสามารถในการตรวจวัดแก๊ส ้ไฮโครเจนได้ดี และในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 250 แ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงแรกและค่อย ๆ ลคลงเมื่อเซนเซอร์ ้สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจน คาคว่าเป็นผลมาจากในระหว่างที่อนุภาคแพลเลเดียมมีการดูคซับโมเลกุล ้ของแก๊สไฮโครเจนอนุภาคแพลเลเดียมเกิดการพอง เนื่องจากเกิดการขยายตัวเชิงปริมาตรของ ้อนุภาคแพลเลเดียม ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคลดลง จนกระทั่งอนุภาคที่อยู่ชิดกันสัมผัสกัน ดังนั้นจึงทำให้ความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนลดลง (Gupta et al., 2014) และยัง พบว่าหลังจากที่ให้ความร้อนแก่ระบบที่อุณหภูมิ 90 ⁶C ภายใต้การไหลของอากาศแห้ง (Dry air) ใน กระบวนการการคืนตัว (Recovery process) เพื่อกำจัดโมเลกุลของไฮโครเจนที่ถูกดูดซับใน เซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจนออก ความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้น (R,) ลคลงจากเดิมเล็กน้อยในเซนเซอร์ แก๊สไฮโครเจนที่เกลือบด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ปริมาตรสารละลาย 50 µl, 100 µl, และ 150 μ1 และความต้านทานไฟฟ้าเริ่มต้นลดลงอย่างรุนแรงในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่เคลือบด้วย อนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ปริมาตรสารละลาย 200 μl และ250 μl คาคว่าเป็นผลมาจากการตกค้าง ้ของสารละลายของ PVP ที่ใช้เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุมรูปร่างของอนุภาคใน กระบวนการสังเคราะห์อนภาคนาโนแพลเลเดียม เมื่อทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมลงบน แผ่นแกรฟืนอาจทำให้เกิดการเคลือบสารละลาย PVP ลงบนเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนด้วย ส่งผลทำ ให้การเชื่อมต่อระหว่างอนุภาคนาโนแพลเลเดียมแต่ละอนุภาคและการเชื่อมต่อระหว่างอนุภาคนา

โนแพลเลเดียมกับแกรฟินแน่นเกินไป เพราะฉะนั้นในระหว่างกระบวนการคืนตัวที่มีการให้ความ ร้อนแก่ระบบ ผลของความร้อนอาจส่งผลทำให้เกิดการการอ่อนตัวของ PVP ที่เคลือบบนเซนเซอร์ แก็สไฮโดรเจน ทำให้การเชื่อมต่ออนุภาคนาโนแพลเลเดียมสองอนุภาคที่อยู่ใกล้กันและการเชื่อม ระหว่างอนุภาคนาโนแพลเลเดียมกับแกรฟินเกิดการกลายตัว ส่งผลทำให้ความด้านทานไฟฟ้า เริ่มต้นลดลงจากเดิมดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ในงานวิจัยนี้ ทำการนำเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd-NP/Gr -11.1 ที่ทำการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 150 μl ลงบนแผ่นแกรฟิน มา ทำการศึกษาผลของความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนต่อความสามารถในการตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจนต่อไป เนื่องจากเซนเซอร์ที่เงื่อนไขดังกล่าวมีความเสถียรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ เงื่อนไขอื่นที่ทำการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนที่สภาวะเดียวกันและเซนเซอร์ที่เงื่อนไขดังกล่าวยังมี การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนที่เห็นได้อย่างชัดเจน



ภาพที่ 38 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ที่อุณหภูมิห้อง โดยเคลือบอนุภาคแพลเลเดียมลงบนแผ่นแกรฟืนที่ปริมาตรสารละลาย 50, 100, 150, 200 และ 250 µl

4.5.3 ผลของความเข้มข้นแก๊สไฮโดรเจนต่อการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน

หลจากการตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่ทำการ เคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 150 μl บนแผ่นแกรฟืน เมื่อสัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนที่ ความเข้มข้นในช่วงตั้งแค่ 1,500 ppm ถึง 6,000 ppm ณ อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพที่ 39 (ก) พบว่า หลังจากเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนสัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงความด้านทาน ไฟฟ้าของเซนเซอร์เพิ่มเมื่อความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น โดยค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทาน ไฟฟ้าของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น จาก 0.84%, 1.66%, 2.04% และ 2.77% เมื่อเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊ส ไฮโดรเจนที่ความเข้มข้น 1,500 ppm, 3,000 ppm, 4,500 ppm และ 6,000 ppm ตามลำดับ จากภาพที่ 39 (ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความด้านทาน ไฟฟ้ากับรากที่สองของความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโดรเจน แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นไปตามทฤษฎีการดูดซับของแลงเมียร์ที่อุณหภูมิคงที่ (The Langmuir adsorption isotherm theory) ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ในส่วนของบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



ภาพที่ 39 การตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนในเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่ทำการเคลือบ สารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 150 µl บนแผ่นแกรฟีน (ก) เปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของตัวตรวจจับแก๊สเมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ ความเข้มข้นในช่วงตั้งแต่ 1,500 – 6,000 ppm (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าและรากที่สองของความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจน

4.5.4 การคำนวณค่าขีดจำกัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) ของเซนเซอร์ แก๊สไฮโดรเจน

ค่าขีดจำกัดการตรวจวัด คือ ค่าความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนต่ำสุดที่เซนเซอร์สามารถ ตรวจวัดได้ ในงานวิจัยนี้ทำการคำนวณหาค่า LOD ของเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่ เคลือบสารละลายแพลเลเดียม 150 µl บนแผ่นแกรฟืนเมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนที่ความเข้มข้น ในช่วงตั้งแต่ 1,500 -6,000 ppm โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณจากงานวิจัยของ Katherine et al. (2012) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ คำนวณหาค่าสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์โดยใช้ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (The root mean square, rms_{noise}) ด้วยการนำข้อมูล 20 จุด ที่ได้จากการตรวจวัดแก๊สของเซนเซอร์ ก่อนที่เซนเซอร์จะสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการ ตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจน ($\Delta R/R_0$) โดยใช้สมการพหุนามอันดับ 5 ในการเขียนกราฟ (A fifth order polynomial fitting) และคำนวณหาค่า V_{x2} ได้จากสมการที่ (7)

$$V_{x^2} = \sum (Y_i - Y)^2 \tag{7}$$

เมื่อ Y_i คือ ค่าการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนและ Y คือ ค่าที่ได้จากการเขียนกราฟด้วยสมการ พหุนามอันดับ 5 และคำนวณค่า rms_{noise} ได้จากสมการที่ (8)

$$rms_{noise} = \sqrt{\frac{V_{x^2}}{N}}$$
(8)

เมื่อ N คือ จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการเขียนกราฟด้วยสมการพหุนามอันดับ 5 ในงานวิจัยนี้ N = 20 และสุดท้ายคำนวณก่าขีดจำกัดการตรวจวัดได้จากสมการที่ (9)

$$LOD = 3 \frac{(rms_{noise})}{slope}$$
(9)

โดยก่ากวามชั้น (Slope) ในสมการที่ (9) หาได้จากกวามชั้นของกราฟเส้นตรงที่แสดงกวามพันธ์ ระหว่างกวามเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนและเปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน (ΔR/R₀ %) ในงานวิจัยนี้ คำนวณค่า V_x² มีค่าเท่ากับ 6.85 × 10⁻⁷ จากนั้นนำค่า V_{x²} ที่คำนวณได้แทน ค่าในสมการที่ (8) ได้ค่า rms_{noise} เท่ากับ 1.85 × 10⁻⁴ หลังจากนั้นนำค่า rms_{noise} และค่าความชันของ กราฟเส้นตรงที่แสดงความพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโครเจนและเปอร์เซ็นต์การ ตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจนซึ่งมีค่าเท่ากับ 4 × 10⁻⁴ แทนค่าในสมการที่ (9) ได้ค่า LOD เท่ากับ 1.38 เพราะฉะนั้นเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียม 150 µ1 บน แผ่นแกรฟืนสามารถตรวจวัดแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้นต่่าสุดประมาณ 1 ppm

4.5.5 เวลาที่ใช้ในการตอบสนองและคืนตัวในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน

ผลจากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจน (Response time, τ_S) ของ เซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียม 150 µl โคยเวลาที่ใช้ใน การตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจนคำนวณได้จากเวลาที่ใช้ในการตอบสนองที่ระดับ 90 % เทียบกับ ค่าการตอบสนองสูงสุดในขณะที่เซนเซอร์สัมผัสกับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้นในช่วงตั้งแต่ 1,500 ppm ถึง 6,000 ppm คังแสดงในภาพที่ 40 (ก-ง) พบว่า ในขณะที่เซนเซอร์สัมผัสกับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้นต่ำ เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรา การดูดซับแก๊ส ไฮโครเจนช้าลง (Kuru et al., 2016) โดยเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโครเจนเพิ่มขึ้นจาก 8.19 นาที, 15.13 นาที, 15.39 นาที และ 18.46 นาที เมื่อเซนเซอร์สัมผัสกับ แก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm, 4,500 ppm, 3,000 ppm และ 1,500 ppm ตามลำคับ



ภาพที่ 40 เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน (τ_S) ของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียม 150 μ1 ลงบนแกรฟีน เมื่อสัมผัสกับ แก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น (ก) 1,500 ppm, (ข) 3,000 ppm, (ก) 4,500 ppm และ (ง) 6,000 ppm

ผลจากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการคืนตัว (Recovery time, τ_R) ของเซนเซอร์แก๊ส ใฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบสารละลายแพลเลเดียม 150 µl โดยเวลาที่ใช้ในการคืนตัว คำนวณได้จากเวลาที่ใช้ในการกลับคืนสู่ค่าความต้านทานไฟฟ้าเริ่มด้นที่ระดับ 90% ในขณะที่ทำ การปิดแก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และทำการให้กวามร้อนแก่ระบบที่อุณหภูมิ 90 °C ภายใต้การไหลของอากาศแห้งเป็นเวลา 10 นาที ต่อมาปล่อยให้ระบบเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้การไหลของแก๊ส ในโตรเจนดังแสดงในภาพที่ 41 (ก-ง) พบว่า เวลาที่ใช้ในการคืนตัวของ เซนเซอร์เพิ่มขึ้นจาก 16.42 นาที, 17 นาที, 20.42 นาที และ 22.57 นาที หลังจากเซนเซอร์สัมผัสกับ แก๊ส ไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 1,500 ppm, 3,000 ppm, 4,500 ppm และ 6,000 ppm ตามลำคับ เนื่องจากสัคส่วนของอนุภาคแพลเลเดียมที่ถูกปกคลุมด้วยโมเลกุลแก๊ส ไฮโครเจนแปรผันตามความ



เข้มข้นของแก๊ส ไฮโครเจน คังนั้นที่ความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโครเจนต่ำ จึงทำให้ใช้เวลาในการคืนตัว สั้นกว่า (Kuru et al., 2016)

ภาพที่ 41 เวลาที่ใช้ในการคืนตัว ($au_{
m R}$) ของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโครเจน Pd-NP/Gr-11.1 ที่เคลือบ สารละลายแพลเลเคียม 150 µ1 ลงบนแกรฟีน หลังจากสัมผัสกับแก๊ส ไฮโครเจนที่ความ เข้มข้น (ก) 1,500 ppm, (ข) 3,000 ppm, (ก) 4,500 ppm และ (ง) 6,000 ppm
อภิปรายและสรุปผล

บทที่ 5

งานวิจัยนี้ได้สร้างเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจนด้วยการกระจายตัวของอนุภาคนาโน แพลเลเดียมบนแผ่นแกรฟีน (Pd-NP/Gr) โดยในส่วนแรกทำการสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นฟอยด์ ทองแดงด้วยวิธี CVD โดยใช้แก๊สอะเซทิลีนเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอนเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมใน การสังเคราะห์แกรฟีน ซึ่งพบว่าการสังเคราะห์แกรฟีนที่อุณหภูมิ 850 °C และ 880 °C ภายใต้การ ใหลของแก๊สอะเซทิลีนที่อัตราการไหล 17 sccm เป็นเวลา 5, 7 และ 10 นาที เป็นเงื่อนไขที่ เหมาะสม และเมื่อทำการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์แกรฟีนต่อโครงสร้าง ของแกรฟีนที่เกิดบนแผ่นฟอยด์ทองแดงด้วยเทคนิกรามานสเปกโตรสโกปี ซึ่งพบว่าแกรฟีนที่ เตรียมได้ทุกเงื่อนไขเป็นแกรฟีนหลายชั้น โดยจำนวนชั้นของแกรฟีนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการ สังเคราะห์แกรฟีนมากขึ้นและการสังเคราะห์แกรฟินที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้โครงสร้างของแกรฟีนมี ความเสถียรและมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ในส่วนที่สอง ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลิออล โดยใช้ แพลเลเดียมคลอไรค์เป็นสารตั้งค้น พอลิเมอร์ PVP เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุมรูปร่าง ของอนุภาค และใช้เอทิลีนไกลคอลเป็นทั้งตัวรีดิวซ์และตัวทำละลาย ควบคุมขนาดและรูปร่างของ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมจากปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรค์ 0.06 g, 0.2 g, 0.4 g และ 0.6 g ทำการศึกษาผลของปริมาณแพลเลเดียมคลอไรค์ต่อขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโนแพลเลเดียม ด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก TEM พบว่าอนุภาคนาโนแพลเลเดียมมีรูปร่างเป็นทรงกลม ทรงหก เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยม โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเพิ่มขึ้น เมื่อใช้ ปริมาณของแพลเลเดียมคลอไรค์ในกระบวนการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น

ในส่วนที่สาม ทำการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาคขนาดต่าง ๆ ลงบนแผ่นแกรฟืนดังนี้ 7.7 nm (Pd-NP/Gr -7.7), 10.1 nm (Pd-NP/Gr -10.1), 11.1 nm (Pd-NP/Gr -11.1) และ 12 nm (Pd-NP/Gr -12) และทำการศึกษาความสามารถในการ ตรวจวัดแก๊ส ไฮโดรเจนของเซนเซอร์แก๊ส ไฮโดรเจนชนิดต่าง ๆ หลังจากสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนที่ ความเข้มข้น 6,000 ppm พบว่า เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่อแก๊ส ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นจนถึงค่าสูงสุด ประมาณ 2.26% ในเซนเซอร์แก๊สไฮโดรเจน Pd-NP/Gr -11.1 ที่ทำการเคลือบอนุภาคนาโน แพลเลเดียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ย 11.1 nm ลงบนแผ่นแกรฟืนและค่า เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนลดลง เมื่อมีการเคลือบอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ยมากกว่า 11.1 nm คาดว่าเป็นผลมาจากขนาดของอนุภาคที่ เพิ่มขึ้น อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมลดลง ส่งผลทำให้พื้นที่ผิวใน การดูดซับโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนลดลง

ในส่วนที่สี่ นำอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่งนาคเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 11.1 nm (Pd-NP/Gr -11.1) ซึ่งมีความเสถียรและมีการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนดีที่สุดมาทำการปรับปรุง ้คุณสมบัติเพื่อเพิ่มค่าการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน โคยทำการควบคุมความหนาแน่นของ ้อนภาคนาโนแพลเลเดียมที่กระจายบนแผ่นแกรฟีนจากการเคลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 50 แl, 100 แl, 150 แl, 200 แl และ 250 แl ลงบนแผ่นแกรฟืน และทำการศึกษาผลของปริมาตร ้สารถะถายแพลเลเดียมต่อความหนาแน่นของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่กระจายตัวบนแผ่น แกรฟืนจากการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายจาก SEM ที่ขนาดพื้นที่ 4.471 แm² พบว่า ความหนาแน่นของ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่กระจายตัวบนแผ่นแกรฟืนเพิ่มขึ้น เมื่อทำการเคลือบสารละลาย แพลเลเดียมที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นลงบนแผ่นแกรฟีน หลังจากนั้นทำการศึกษาความสามารถในการ ้ตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจนที่เกลือบด้วยสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร ต่าง ๆ ลงบนแผ่นแกรฟีน เมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่งพบว่า เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนเพิ่มขึ้นจนถึงก่าสุงสุดประมาณ 3.90% ในเซนเซอร์ ้แก๊สไฮโครเจนที่ทำการเคลือบสารละลายแพลเลเคียมที่ปริมาตร 200 ul และเปอร์เซ็นต์การ ้ตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนลคลงเมื่อทำการเกลือบสารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตรมากกว่า 200 μl ลงบนแผ่นแกรฟืน แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมบนแผ่น แกรฟืนที่ความหนาแน่นระดับปานกลางมีความสามารถในการตรวจวัคแก๊สไฮโครเจนได้ดีที่สุด การกระจายตัวของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมที่ความหนาแน่นน้อยหรือมากบนแผ่นแกรฟืนไม่ใช่ เงือนไขที่มีความสามารถในการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจนได้ดีที่สุด

ในส่วนที่ห้า ทำการนำเซนเซอร์แก๊สไฮโครเจน Pd-NP/Gr -11.1 ที่ทำการเคลือบ สารละลายแพลเลเคียมที่ปริมาตร 150 µl ลงบนแผ่นแกรฟืน มาทำการศึกษาผลของความเข้มข้น ของแก๊สไฮโครเจนต่อความสามารถในการตรวจวัดแก๊สไฮโครเจน เนื่องจากเงื่อนไขที่มีการเคลือบ สารละลายแพลเลเดียมที่ปริมาตร 150 µl ลงบนแผ่นแกรฟืนมีความเสถียรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ กับเงื่อนไขอื่นที่ทำวัดแก๊สไฮโครเจนที่สภาวะเดียวกัน หลังจากเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ ความเข้มข้นในช่วงตั้งแต่ 1,500 – 6,000 ppm พบว่า เปอร์เซ็นต์การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจน เพิ่มขึ้น เมื่อเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้นสูงขึ้น โดยเซนเซอร์สามารถตรวจวัด แก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้นต่ำสุคประมาณ 1 ppm และยังพบว่าเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อ แก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์น้อยลงเมื่อสัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้นสูงขึ้น เนื่องจากที่ ความเข้มเข้นของแก๊สไฮโครเจนต่ำ อัตราการดูดซับแก๊สไฮโครเจนช้าลง จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการ ตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์มากกว่า ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการคืนตัวเพิ่มขึ้น หลังจากเซนเซอร์สัมผัสกับแก๊สไฮโครเจนที่ความเข้มข้นสูงขึ้น เนื่องจากสัคส่วนของอนุภาค แพลเลเดียมที่ถูกปกคลุมค้วยโมเลกุลแก๊สไฮโครเจนแปรผันตามความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจน ดังนั้นที่ความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนต่ำ จึงทำให้ใช้เวลาในการคืนตัวสั้นกว่า

ข้อเสนอแนะ

หลังจากกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียมด้วยวิธีโพลิออล ควรนำผงของ อนุภาคนาโนแพลเลเดียมไปทำการเผาที่อุณหภูมิในช่วง 300 – 450 °C ภายใต้บรรยากาศของแก๊ส ในโตรเจนหรือแก๊สอาร์กอน เพื่อกำจัดพอลิเมอร์ PVP ที่ใช้เป็นสารป้องกันการรวมตัวและควบคุม รูปร่างของอนุภาคในกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนแพลเลเดียม เนื่องจากถ้ามีพอลิเมอร์ PVP ตกก้างจะส่งผลกระทบต่อสมบัติทางไฟฟ้าและการตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนของเซนเซอร์ เนื่องจากเปลือกที่เป็นฉนวนของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนแพลเลเดียมจะไปลดความสามารถ ในการดูดซับโมเลกุลของแก๊สไฮโครเจน ส่งผลทำให้การตอบสนองต่อแก๊สไฮโครเจนลคลง และ ผลของพอลิเมอร์ที่ตกก้างทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอนุภาคแต่ละอนุภาคและการเชื่อมต่อระหว่าง อนุภาคนาโนแพลเลเดียมกับแกรฟีนแน่นเกินไป ส่งผลทำให้กวามด้านทานไฟฟ้าในสองมิติหรือ แผ่น (Sheet resistance) เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม

- Ando, Y., & Zhao, X. (2006). Synthesis of carbon nanotubes by arc-discharge method. New diamond and frontier carbon technology, 16, 123-137.
- Chung, M. G., Kim, D. H., Seo, D. K., Kim, T., Im, H. U., Lee, H. M., Beom, J., Hong, S. H., Kang, T. J., & Kim, Y. H. (2012). Flexible hydrogen sensors using graphene with palladium nanoparticle decoration. *Sensor and Actuators*, 169, 387-392.
- Edward, R. S., & Coleman, K. S. (2013). Graphene synthesis: Relationship to application. *Nanoscale, 5,* 38-51.
- Galib, O. F. M. A. (2012). Graphene grown by chemical vapor deposition on evaporated copper thin films. Master's thesis, Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology.
- Garg, B., Bisht, T., & Ling, Y. C. (2014). Graphene-based nanomaterials as heterogeneous acid catalysts: a comprehensive perspective. *Molecules*, *19*, 14582-14614.
- Gupta, D., Dutta, D., Kumar, M., Barman, P. B., Sarkar, C. K., Basu, S., & Hazra, S. K. (2014). A low temperature hydrogen sensor based on palladium nanoparticles. *Sensors and Actuators B, 196,* 215–222.
- Gupta, R. B. (2009). Hydrogen fuel: Production, transport, and storage. Boca Raton: CRC Press.
- Hei, H., He, H., Wang, R., Liu, X., & Zhang, G. (2012). Controlled synthesis and characterization of noble metal nanoparticles. *Soft Nanoscience Letter*, 2, 34-40.
- Hibino, H., Kageshima, H., & Nagase, M. (2010). Graphene growth on silicon carbide. Special Feature, 8, 1-6.
- Hong, J., Lee, S., Seo, J., Pyo, S., Kim, J., & Lee, T. (2015). A highly sensitive hydrogen sensor with gas selectivity using a PMMA membrane-coated Pd nanoparticle/single-layer graphene hybrid. ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 3554–3561.
- Katherine, A. M., Jonathan, G. W., Jan, M. S., Birgit, E., & Timothy, M. S. (2012). Mechanical drawing of gas sensors on paper. *Angewandte Chemie*, s1-s19.
- Kim, J., Seo, J., Jung, K. H., Kim, S. H., & Lee, H. W. (2012). The effect of various parameters for few-layered graphene synthesis using methane and acetylene. *Journal of Ceramic Processing Research*, 13, s42-s46.

- Kumar, A., & Lee, C. H. (2013). Synthesis and biomedical applications of graphene: Present and Future Trends. In M. Aliofkhazraei (Ed.), *Advances in Graphene science*. n.p.
- Kumar, R., Malik, S., & Mehta, B. R. (2015). Interface induced hydrogen sensing in Pd nanoparticle/graphene composite layers. *Sensors and Actuators B, 209*, 919–926.
- Kuru, C., Choi, D., Kargar A., Liu, C. H., Yavuz, S., Choi, C., Jin, S., & Bandaru, P. R. (2016). High-performance flexible hydrogen sensor made of WS2 nanosheet–Pd nanoparticle composite film. *Nanotechnology*, 27, 195501.
- Mohsin, A. (2012). *Graphene synthesis and characterization on copper*. Master's thesis, Electrical and Computer Engineering, The Graduate College, University of Iowa.
- Muñoz, B., & Aleixandre, C. G. (2013). Review of CVD synthesis of graphene. *Chemical Vapor Deposition, 19,* 297–322.
- Mwakikunga, B. W., & Hillie, K. T. (2011). Graphene synthesis, catalysis with transition metals and their interactions by laser photolysis. In J. R. Gong (Ed.), *Graphene - synthesis, characterization, properties and applications* (p. 61). n.p.
- Nguyen, V. T., Le, H. D., Nguyen, V. C., Ngo, T. T. T., Le, D. Q., Nguyen, X. N., & Phan, N. M. (2013). Synthesis of multi-layer graphene films on copper tape by atmospheric pressure chemical vapor deposition method. *Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, 4*, 035012.
- Noh, J. S., Lee, J. M., & Lee, W. (2011). Low-dimensional palladium nanostructures for fast and reliable hydrogen gas detection. *Sensor*, *11*, 825-851.
- Phan, D. T., & Chung, G. S. (2014 a). Reliability of hydrogen sensing based on bimetallic Ni-Pd/graphene composites. *International journal of hydrogen energy*, 39, 20294-20304.
- Phan, D. T., & Chung, G. S. (2014 b). Effect of Pd nanocube size of Pd nanocub-graphene hybrid on hydrogen sensing properties. *Sensors and Actuators, 204,* 437–444.
- Phan, D. T., & Chung, G. S. (2014 c). Characteristics of resistivity-type hydrogen sensing based on palladium-graphene nanocomposites. *International journal of hydrogen* energy, 39, 620-629.

- Singh, V., Joung, D., Zhai, L., Das, S., Khondaker, S. I., & Seal, S. (2011). Graphene based materials: Past, present and future. *Progress in Materials Science*, 56, 1178–1271.
- Tripathi, P., Patel, Ch. R. P., Shaz, M. A., & Srivastava, O. N. (n.d.). *Synthesis of high-quality* graphene through electrochemical exfoliation of graphite in alkaline electrolyte. n.p.
- Wang, B., Zhang, H. R., Zhang, Y. H., Chen, Z. Y., Jin, Z., Liu, X. Y., Hu, L. Z., & Yu, G. H. (2014). Effect of Cu substrate roughness on growth of graphene domains at atmospheric pressure. *Materials letters*, 131, 138-140.
- Weiß, N., Meskamp, L. M., Selzer, F., Bormann, L., Eychmüller, A., Leo, K., & Gaponik, N. (2015). Humidity assisted annealing technique for transparent conductive silver nanowire networks. *RSC Adv.*, *5*, 19659–19665.
- Wong, H. S. P., & Akinwande, D. (2011). Carbonnanotube and graphene device physics. New York: Cambridge University Press.
- Xiao, B., Li, X., Li, X., Wang, B., Langford, C., Li, R., & Sun, X. (2014). Graphene nanoribbons derived from the unzipping of carbon nanotubes: Controlled synthesis and superior lithium storage performance. *The Journal of Physical Chemistry C*, 118, 881-890.